



"ELECTRODEPÓSITO DE Cu₂O SOBRE ELECTRODOS NANOESTRUCTURADOS DE TiO₂ MODIFICADOS CON DENDRÍMEROS PAMAM PARA APLICACIONES EN DISPOSITIVOS DE TRANSDUCCIÓN DE ENERGÍA QUÍMICA EN ELECTRICIDAD"

TESIS PRESENTADA POR:

I.Q. BRENDA VANESSA MORALES PONCE

PARA OBTENER EL GRADO DE:

MAESTRÍA EN ELECTROQUÍMICA

JULIO, 2010

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica

REALIZADO POR:

I.Q Brenda Vanessa Morales Ponce

DIRIGIDA POR

Dr. Juan Manríquez Rocha

SINODALES

Dr. Luis Godínez Mora-Tovar Presidente

Dr. Juan Manríquez Rocha Secretario

Dr. Luis Antonio Ortiz Frade Vocal Firma

Firma

Firma

Las propiedades electroquímicas asociadas a los semiconductores siguen motivando su obtención con la finalidad de aplicarlos en el desarrollo de dispositivos novedosos, que generen potencia eléctrica con base en tecnologías ambientalmente compatibles. En este contexto, el Cu₂O es un óxido semiconductor barato y de baja toxicidad sumamente atractivo para su utilización en las aplicaciones arriba mencionadas. En este trabajo de investigación se optimizaron los parámetros de electrodepósito de Cu₂O sobre películas de TiO₂ nanoestructurado, con la finalidad de averiguar preliminarmente sus propiedades de transducción de energía química en potencia eléctrica.

En el capítulo 1 se plantean los aspectos teóricos de los semiconductores como requisitos esenciales para comprender el comportamiento electroquímico de las películas de TiO₂ y Cu₂O, que son los materiales clave para la construcción de heterouniones TiO₂/Cu₂O.

En el capítulo 2 se discute y plantea a la técnica de electrodepósito como viable para la obtención de las películas de Cu₂O en medio ácido. Así mismo se propone que la eficiencia de depósito de este semiconductor podría ser mejorada con el empleo de dendrímeros PAMAM, previamente confinados en la superficie de electrodos nanoestructurados de TiO₂.

En el capítulo 3 se muestran los resultados concernientes a la optimización de la técnica de electrodepósito de Cu₂O sobre películas de TiO₂ funcionalizadas con dendrímeros. Finalmente, en el capítulo 4, fue llevada a cabo la exploración preliminar del empleo de películas de TiO₂/Cu₂O como ánodos de dispositivos de transducción de energía química en potencia eléctrica.

ABSTRACT

Associated electrochemical properties to semiconductors still motivate its synthesis in order to applying them into the development of novel devices, which can generate electric power through ecologically compatible technologies. Cu₂O in this context is a cheap and nontoxic semiconductor oxide, strongly attractive for being employed into the mentioned applications. In this investigation, were optimized the parameters for carrying out the electrodeposition of Cu₂O over nanostructured TiO₂ films, in order to figure out preliminary their properties as transducer of chemical energy into electric power.

Theoretical aspects about the semiconductors were discussed in chapter 1 as the basics for understanding the electrochemical behavior of TiO_2 and Cu_2O films, which are the key materials for the construction of TiO_2/Cu_2O heterojunctions.

Electrodeposition technique is discussed and proposed in chapter 2, as a viable way for obtaining Cu_2O films in acidic medium. Covalent confinement of PAMAM-type dendrimers over TiO₂ surfaces were also proposed as a strategy for improving the deposition efficiency of this oxide semiconductor.

Chapter 3 shows the results concerning the optimization of the technique of electrodeposition of Cu_2O on TiO_2 films containing dendrimers, leading to the generation of TiO_2/Cu_2O heterojunctions.

Results concerning to the optimization of the Cu_2O electrodeposition over dendrimerfunctionalized TiO₂ films were presented in chapter 3. Finally, the preliminary exploration of TiO₂/Cu₂O films as anodes contained in devices for converting the chemical energy into electric power were carried out in chapter 4.



Este trabajo fue realizado en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ), bajo la dirección del Dr. Juan Manríquez Rocha

Con todo mi amor y respeto a mis padres (Juan Morales y Esthela Ponce)

Agradecímentos

A Dios por darme la oportunidad de finalizar un logro mas en mi vida.

A mis padres Juan y Esthela, porque gracías a sus consejos y a su siempre incondicional apoyo, he logrado cumplir con cada una de mis metas.

A Jesús y mis hermanos, Juan Carlos, Ricardo, César y Edgar, gracías por su apoyo, así como a Sarahí y mis sobrinos Ervin y Gabriel.

A mís amigos Vanessa, Octavio, Daniel y Juliana, que estuvieron conmigo durante toda esta etapa, compartiendo aventuras, experiencias y desveladas.

Al Dr. Juan Manríquez Rocha, por su asesoramiento científico y estímulo para seguir creciendo intelectualmente

Al Dr. Luís Antonio Frade Ortiz y al Dr. Luís Arturo Godinez Mora-Tovar, por sus valiosas sugerencias y acertados aportes durante el desarrollo de la tesis.

A CIDETEQ por la oportunidad de realizar este trabajo y a CONACyT por la beca otorgada durante la realización de este proyecto

Y a todas aquellas personas que de una u otra forma, colaboraron o participaron en la realización de esta investigación, hago extensivo mi más sincero agradecimiento.

CONTENIDO

1
4
4
4

Capitulo 1

•							
Fundamentos	teóricos	de	electrodos	semiconductores	másicos	у	
nanoestructura	ados						5
1. Bases teórica	as de los ma	aterial	les semicondu	ctores			6
1.1 Semi	conductores	s más	sicos				6
1.2 Clasif	ficación de l	os se	miconductore	s másicos			8
1.2	2.1 Semicor	nducto	ores intrínseco)S			8
1.2	2.2 Semicor	nducto	ores extrínsec	OS			8
1.3 Nivel	de Fermi						9
1.4 Interfa	ase semico	nduct	or – electrolito)			12
1.5 Semo	conductores	nanc	oparticulados				15
1.6 Heter	oestructura	s sen	niconductoras				16
2. Conclusiones	5						18

Capitulo 2

Técnicas y problemática relacionadas con el depósito de películas de Cu ₂ O	
y materiales dendríticos como acomplejantes de iones Cu(II)	19

1 Generalidades sobre el Cu ₂ O	20
1.1 Procesos de descomposición fotoasistida en semiconductores	21
2 Técnicas de depósito de Cu ₂ O	22
2.1 Spray pirolisis	22
2.2 Depósito químico en fase vapor	22
2.3 Pulverización catódica o sputtering	23
2.4 Electrodepósito o depósito electroquímico	24
2.4.1 Fundamentos básicos de la técnica de electrodepósito	24

2.4.2 Antecedentes del electrodepósito de Cu ₂ O	25
2.4.3 Comportamiento tipo p y n del Cu ₂ O y su relación con	25
vacancias de cobre y oxígeno	
3 Energética de las superficies de TiO ₂ /p-Cu ₂ O y TiO ₂ /n-Cu ₂ O	28
4 Materiales dendríticos	30
4.1 Dendrímeros de tipo poliamidoamina	31
4.2 Propiedades ácido base y complejantes de los dendrímeros PAMAM	
frente a los iones Cu(II)	33
5. Conclusiones	35

Capitulo 3

Obtención y caracterización de electrodepósitos de Cu ₂ O sobre electrodos	
nanoestructurados de TiO2 modificados con dendrímeros poliamidoamina	36
1. Electrodos nanoestructurados de TiO ₂	37
1.1 Fundamentos del método de depósito electroforético	37
1.2 Obtención de películas nanoestructuradas de TiO ₂ sobre láminas	
de Ti	39
1.3 Metodología experimental	39
1.4 Resultados y discusión	42
1.4.1 Microscopia óptica	42
1.4.2 Difracción de rayos X (XRD)	44
1.4.3 Reflectancia difusa y espectroscopia de fotocorriente	45
1.5 Conclusiones	50
2. Obtención de películas de Cu ₂ O tipo n mediante la técnica de electrodepósito	50
2.1 Metodología experimental	50
2.1.1 Influencia del potencial aplicado	51
2.1.2 Influencia del tiempo de electrodepósito	54
2.2 Resultados y discusión	55
2.2.1 Perfilometría	55
2.2.2 Difracción de rayos X (XRD)	56
2.3 Conclusiones	58
3. Electrodepósito de Cu ₂ O sobre OTE modificado con dendrímeros PAMAM	58
3.1 Metodología experimental	58

3.2 Resultados y discusión	62
3.2.1 Difracción de rayos X (XRD)	62
3.2.2 Microscopía electrónica de barrido (SEM)	64
3.3 Conclusiones	65
4. Comportamiento semiconductor extrínseco de las películas de Cu ₂ O	65
4.1 Metodología experimental	65
5 Obtención de nanoestructuras de TiO ₂ /Cu ₂ O sobre electrodos de Ti	68
5.1 Metodología experimental	68
5.2 Resultados y discusión	68
5.2.1 Difracción de rayos X (XRD)	68
5.2.2 Microscopía electrónica de barrido (SEM)	70
5.3 Conclusiones	72

Capitulo 4

Construcción y evaluación preliminar de dispositivos de transducción de	
energía química en potencia eléctrica empleando electrodos de TiO ₂ /Cu ₂ O	73
1. Energías alternativas	74

1.2 Baterías	75
1.3 Componentes básicos de una batería	76
1.3.1 Electrodos	76
1.3.2 Electrolito	77
1.3.3 Separadores	77
1.4 Operación de la celda	77
1.4.1 Proceso de descarga	78
1.4.2 Proceso de carga	78
1.5 Parámetros característicos de una batería	78
1.5.1 Capacidad Q	79
1.5.2 Capacidad especifica Q_{e}	79
1.5.3 Energía específica E_{e}	80
1.5.4 Potencia específica	80
1.6 Clasificación de las baterías de las baterías de acuerdo a la relación	
carga/descarga	80
1.6.1 Pilas primarias	80

1.6.2 Pilas secundarias	81
2. Construcción y evaluación preliminar de baterías empleando electrodos de	
TiO ₂ /Cu ₂ O	81
2.1 Metodología experimental	82
2.1.1 Ensamblado del dispositivo de transducción de energía	
electroquímica tipo pila primaria.	82
2.2 Resultados y discusión	83
2.2.1 Descarga en régimen estacionario de los dispositivos de	
transducción de energía química en electricidad	83
2.2.2 Justificación preliminar de reacción global de las pilas	
ensambladas con ánodos de tipo Ti/TiO ₂ /Cu ₂ O y Ti/TiO ₂ /M-	
Dens/Cu ₂ O	85
2.2.3 Justificación de los potenciales a circuito abierto en	
dispositivos voltaicos ensamblados con ánodos de Ti/TiO ₂ /Cu ₂ O y	
Ti/TiO ₂ /M-Dens/Cu ₂ O	88
2.3 Modificación química de los electrodos de Ti/TiO ₂ /M-Dens/Cu ₂ O	
empleados para ensamblar dispositivos voltaicos	90
2.3.1 Metodología experimental	92
2.3.2 Descarga en régimen estacionario de los dispositivos voltaicos	
ensamblados con ánodos de Ti/TiO ₂ /M-Dens/Cu ₂ O modificados con	
MPA	92
2.4 Propiedades energéticas de los dispositivos voltaicos ensamblados	
con ánodos de Ti/TiO ₂ /M-Dens/Cu ₂ O y Ti/TiO ₂ /M-Dens/Cu ₂ O/MPA	93
2.4.1 Metodología experimental	93
2.4.2 Cálculo de los parámetros energéticos de los dispositivos	
voltaicos	94
2.5 Conclusiones	97
Conclusiones generales y perspectivas a futuro	98
1. Conclusiones generales	99
2. Perspectivas a futuro	100

Anexos

1. Técnicas empleadas	102
1.1 Voltamperometría cíclica	102
1.2 Difracción de rayos X	105
1.3 Microscopía electrónica de barrido	107
1.3.1 Espectroscopia de energía dispersiva de rayos X (EDS)	108
1.4 Perfilometría	109
Referencias	111

ABREVIATURAS EMPLEADAS

APS	3-aminopropil-trietoxisilano
CVD	Depósito químico de vapor (por sus siglas en inglés Chemical Vapor Deposition)
EDC	1-(3-dimetilamino)-propil-3-etilcarbodiimida
EDS	Espectroscopia de Energía Dispersiva de Rayos X (por sus siglas en inglés <i>Energy</i>
FPD	Depósito Electroforético (por sus siglas en inglés <i>Electrophoretic deposition</i>)
E _F	Nivel de Fermi
E°	Potencial redox
FL	Fotoluminiscencia
IPCE	Eficiencia de conversión del fotón incidente a corriente (por sus siglas en inglés <i>Incident-Photon-to-Current-Efficiency</i>)
M-Dens	Modificación con dendrímeros
OC OTE	Circuito abierto (por sus siglas en inglés <i>Open Circuit</i>) Electrodo ópticamente transparente (por sus siglas en inglés <i>Optically transparent</i> <i>electrode</i>)
PAMAM	Poliamidoamina
PC	Carbonato de Propileno (por sus siglas en inglés Carbonate Propylene)
PS	Espectroscopia de fotocorriente (por sus siglas en inglés Photocurrent Spectroscopy)
RPE	Resonancia Paramagnética de Electrón
SEM	Microscopia de barrido electrónico (por sus siglas en inglés <i>Scanning Electrode Microscopy</i>)
UV-Vis	Ultravioleta-visible
VC	Voltamperometría cíclica
XRD	Difracción de rayos X (por sus siglas en inglés X-Ray Diffraction)

Introducción general y justificación

"Las ciencias aplicadas no existen, solo las aplicaciones de la ciencia"

Louís Pasteur

INTRODUCCIÓN GENERAL Y JUSTIFICACIÓN

La nanotecnología constituye una verdadera revolución científico/tecnológica porque recientemente ha impactado en casi todos los campos de investigación. Esto se debe fundamentalmente a que los seres humanos hemos adquirido la habilidad de manipular y organizar sistemáticamente la materia en un nivel nanométrico (1-100nm). Como ejemplo específico, el diseño de materiales en nanoescala, sus métodos de caracterización, manipulación y ensamblaje han dado lugar a un contexto radicalmente novedoso para desarrollar fuentes de energía eficientes, económicamente convenientes y poco contaminantes.

Para lograr la construcción de materiales estructurados que tengan una influencia directa sobre los rendimientos electroquímicos de conversión de energía química en eléctrica, se han desarrollado nuevos procedimientos electro- y químicos de síntesis, esperando con esto modificar las propiedades texturales y morfológicas que tengan influencia sobre el área electroactiva. En este contexto el Cu₂O es un material de gran importancia para la generación de energía fotovoltaica de bajo costo. Sin embargo, su tendencia a la fotoreducción vía la reacción Cu₂O + 2H⁺ + 2e⁻ $\stackrel{hv}{\rightarrow}$ 2Cu + H₂O ha provocado que sus propiedades fotovoltaicas sean desestimadas. En consecuencia, la exploración de este material como ánodo de pilas primarias ha sido recientemente retomada.

Por su versatilidad e infraestructura sencilla, el depósito electroquímico es la ruta más empleada para la obtención de películas de Cu₂O. Una revisión sistemática de la literatura indica que en la práctica, las películas de Cu₂O son típicamente electrogeneradas en medio acuoso alcalino (Reacciones *i* y *ii*) con la finalidad de evitar la formación de Cu metálico (Reacción *iv*), que es considerado un producto indeseado de la reducción de Cu²⁺ efectuada en medio ácido (Reacción *iii*).

$$Cu^{2+} + e^{-} \rightarrow Cu^{+} \tag{1}$$

 $2\mathrm{Cu}^{+} + 2\mathrm{OH}^{-} \rightarrow \mathrm{Cu}_{2}\mathrm{O} + \mathrm{H}_{2}\mathrm{O} \tag{ii}$

$$2Cu^{2+} + H_2O + 2e^- \rightarrow Cu_2O + 2H^+$$
(*iii*)

$$Cu_2O + 2H^+ + 2e^- \rightarrow 2Cu + H_2O \tag{iv}$$

El contenido de Cu metálico presente como producto secundario en películas de Cu₂O obtenidas mediante electrodepósito debe ser rigurosamente controlado, ya que se ha observado que este metal modifica seriamente las características semiconductoras del óxido metálico en cuestión. En este contexto, el comportamiento tipo p ó n de la películas de Cu₂O ha sido explicado satisfactoriamente en función de la presencia de vacancias de cobre (V_{Cu}) o de oxígeno (V_O), respectivamente. Sin embargo, la relación que existe entre el contenido de Cu metálico en películas de Cu₂O obtenidas por electrodepósito y su comportamiento semiconductor aún no se ha entendido por completo.

En el presente trabajo se estudió la obtención vía electrodepósito y en medio ácido (buffer de acetatos pH 4.5) de películas de Cu₂O sobre electrodos nanoestructurados de TiO₂ previamente modificados con materiales dendríticos. Con la finalidad de evaluar si estos modificadores orgánicos permiten amortiguar los cambios de pH interfacial, experimentos con TiO₂ no modificado también fueron efectuados para comparación. La metodología optimizada no sólo permitiría tener una ruta de obtención de Cu₂O con contenido de Cu metálico regulado, sino también con altos rendimientos de reacción debido a la preconcentración interfacial del Cu²⁺ en las unidades dendríticas vía complejación. Posteriormente, se evaluó el tipo de comportamiento semiconductor (n ó p) para películas mixtas de Cu₂O generadas por electrodepósito en presencia y ausencia de recubrimientos dendríticos.

En la última parte de este trabajo, fueron efectuados experimentos preliminares dirigidos a la evaluación del uso potencial de las películas de TiO₂/Cu₂O estudiadas como ánodos de pilas primarias donde el par triioduro-ioduro se aprovecha en semireacción de reducción.

HIPÓTESIS

Hipótesis 1

Los dendrímeros de poliamidoamina (PAMAM) generación 3.5 contienen 64 grupos COOH periféricos (pK_a~3.8), así como múltiples sitios complejantes de cationes metálicos de tipo amina secundaria (>NH) y terciaria (>N-) en su interior. De esta forma, se infiere que el control de las concentraciones interfaciales tanto de los iones H⁺ y Cu²⁺ en interfases TiO₂/buffer de acetatos pH 4.5 pudiera ser alcanzado una vez que el material dendrítico sea confinado químicamente en la superficie de este óxido semiconductor.

Hipótesis 2

El empleo de películas de TiO₂/Cu₂O como ánodos de pilas primarias podría llevarse a cabo si la oxidación espontánea del Cu₂O fuera provocada por acción de una semireacción de reducción con potencial redox apropiadamente más positivo que el de la película de óxidos.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar y optimizar el electrodepósito de Cu₂O sobre electrodos de TiO₂ nanoestructurado, previamente modificado con materiales dendríticos de tipo poliamidoamina (PAMAM), sumergidos en medio acuoso ácido.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Obtener y caracterizar películas nanoestructuradas de TiO₂ sobre electrodos de Ti (Ti/TiO₂).

Optimizar los parámetros de electrodepósito para la obtención de recubrimientos de Cu₂O sobre electrodos nanoestructurados de Ti/TiO₂ (Ti/TiO₂/Cu₂O), modificados o no con materiales dendríticos.

Obtener una respuesta preliminar de los electrodos de Ti/TiO₂/Cu₂O cuando se los emplea como ánodos en pilas primarias manufacturadas a nivel laboratorio.

Capítulo 1

Fundamentos teóricos de electrodos semiconductores másicos y nanoestructurados

1. Bases teóricas de los materiales semiconductores

1.1 Semiconductores másicos

Las propiedades electrónicas de los sólidos son usualmente descritas en términos del modelo de bandas (Figura 1), el cual se deriva directamente de la distribución estadística de los niveles de energía atómica [1]. Los niveles de energía de átomos aislados tienen valores definidos sin embargo, cuando los átomos se ponen en contacto uno con otro participan en enlaces moleculares, sus orbitales interactúan y las posiciones de los niveles energéticos individuales cambian. Cuando finalmente este conjunto de átomos forma una red cristalina, los niveles de energía individual se combinan para formar bandas de energía [2].





La energía de los electrones en un cristal consiste en grupos de estados de energía llenos y vacíos, llamados bandas de valencia (B.V) y de conducción (B.C), respectivamente. Entre estas bandas de energía existe una zona en la que la

probabilidad de existencia del electrón es casi y se le denomina "bandgap" o banda prohibida [3]. Entonces un semiconductor se puede definir como un material sólido cristalino o amorfo con una energía prohibida moderada, cuya magnitud se encuentra entre las energías prohibidas correspondientes a los conductores y a los aislantes.

En el estudio de las interfases semiconductor-electrolito, es de gran importancia conocer los bordes de banda prohibida, ya que indican las limitaciones termodinámicas en los procesos fotoasisitidos que pudieran ser llevados a cabo por los portadores de carga. En la literatura es común encontrar diagramas energéticos para diversos materiales semiconductores másicos (Figura 2) [4].



Figura 2. Posición de las bandas de energía para varios semiconductores másicos con respecto a la escala del (a) vacío, (b) electrodo normal de hidrógeno (ENH) y (c) electrodo de calomel saturado (ECS).

1.2 Clasificación de los semiconductores másicos

1.2.1 Semiconductores intrínsecos

El semiconductor intrínseco es un material formado por un solo tipo de átomos o de elementos químicos, con una cantidad insignificante de impurezas (n_i) tal y como lo indica la Ecuación 1, donde E_g es la energía del band gap, k_B es la constante de Boltzmann y T la temperatura absoluta.

$$n_i = 2.5 \times 10^{19} \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right) \tag{1}$$

Los cristales puros de silicio son un ejemplo típico de esta clase de semiconductores, donde el número de electrones (*n*) es igual al número de huecos (*p*), $n_i = n = p$. [5]

1.2.2 Semiconductores extrínsecos

Un semiconductor extrínseco resulta de agregar impurezas con átomos de otras sustancias a un semiconductor intrínseco. A este proceso de impureza se le conoce como dopaje y se utiliza para obtener sitios donadores o aceptores de electrones que permitan transportar la carga eléctrica a otros puntos del cristal.

Los semiconductores extrínsecos se dividen en tipo n y p. En los primeros se añade un donador de electrones al sistema, por lo que la concentración de huecos positivos disminuye. De esta forma la concentración de electrones es grande, en comparación con la concentración de huecos, por lo que la conducción se produce predominantemente por los electrones. [6] La concentración de huecos se puede expresar de acuerdo con la Ecuación (2) donde N_D es la concentración de los átomos donadores.

$$p = \frac{n^2}{N_D} \tag{2}$$

De manera simétrica, en un semiconductor tipo p hay una adición de aceptores de electrones al sistema, por lo que la concentración de huecos positivos de la banda de valencia aumenta. Los semiconductores dopados así, conducen la corriente eléctrica fundamentalmente por huecos [6]. La concentración de electrones es definida por la Ecuación 3 donde N_A es la concentración de los átomos aceptores.

$$n = \frac{n^2}{N_A} \tag{3}$$

1.3 Nivel de Fermi

Un concepto importante en la descripción de electrodos semiconductores es el nivel de Fermi (E_F), que define la distribución de electrones y huecos entre los niveles de energía disponibles en un sólido. Dicho de otra manera, todos los niveles de energía por debajo del nivel de Fermi son ocupados por electrones, mientras que todos los niveles por encima del mismo son ocupados por huecos. Desde el punto de vista químico, el nivel de Fermi es una medida de la energía electroquímica (potencial electroquímico $\bar{\mu}_i$) de los electrones en el sólido [4], que se define como:

$$\bar{\mu}_i = \mu_i + z_i F \theta_i \tag{4}$$

donde μ_i es el potencial químico, z_i la carga de la especie *i*, *F* la constante de Faraday y θ_i el potencial interno de la fase.

De acuerdo con la Ecuación 5, el Nivel de Fermi E_F en un semiconductor intrínseco se encuentra entre sus bandas de valencia E_V y de conducción E_C debido a que las masas efectivas de los electrones m_e y de los huecos m_h se asumen iguales.

$$E_F = \frac{E_C + E_V}{2} + \frac{kT}{2} ln \left(\frac{m_h}{m_e}\right)^{3/2}$$
(5)

De esta forma, la concentración de los electrones (donadores) N_D y huecos (aceptores) N_A en un semiconductor determinan la posición del nivel de Fermi E_F , tal y

como lo expresa la Ecuación 6 y 7, donde N_C y N_V son las densidades de los niveles energéticos en la banda de conducción y de valencia, respectivamente.

$$N_D = N_C exp\left[\frac{-(E_C - E_F)}{kT}\right] \tag{6}$$

Para un semiconductor tipo n, el nivel de Fermi se mueve hacia el borde de la banda de conducción mientras que para un semiconductor tipo p se mueve hacia el borde de la banda de valencia (Figura 3).

$$N_A = N_V exp\left[\frac{-(E_F - E_V)}{kT}\right] \tag{7}$$



Figura 3. Posición del nivel de Fermi y densidad de estados ocupados para semiconductores intrínseco, tipo n y tipo p.

Por otro lado, el E_F puede ser controlado aplicando un potencial externo E, de modo que se modifica la concentración de electrones en la superficie respecto a los valores de equilibrio. Cuando el potencial aplicado es tal que no hay diferencia de potencial entre el seno del material y la superficie, las bandas son planas, resultando que la caída de potencial en la región espacial es nula $\Delta \phi_0 = 0$ (Figura 4). Esta condición corresponde a un único potencial para cada sistema, llamado potencial de banda plana E_{fb} .



Figura 4. Interfase semiconductor-electrolito polarizada con respecto a un electrodo de referencia para un semiconductor tipo n. (a) $E > E_{fb}$, la superficie presenta un exceso de carga positiva (agotada en electrones), (b) $E = E_{fb}$, por lo tanto no hay diferencia entre las bandas del seno y la superficie del material y (c) $E < E_{fb}$, existe un exceso de carga negativa en la superficie por acumulación de electrones.

Para óxidos semiconductores y de acuerdo con la Ecuación 8 (donde *R* es la constante de los gases, *T* es la temperatura absoluta, *F* es la constante de Faraday, pH_{ZCP} es el punto isoeléctrico de la superficie del semiconductor y E_{fb}° es el potencial de banda bajo la última condición), el E_{fb} tiene una dependencia de tipo nernstiana con el *pH* en disoluciones acuosas [7].

$$E_{fb} = E_{fb}^{\circ} + 2.303 \frac{RT}{F} (pH_{ZCP} - pH)$$
(8)

1.4 Interfase semiconductor-electrolito

El contacto entre un semiconductor y un electrolito induce un reordenamieno de cargas hasta que el sistema se equilibra eléctricamente, es así como se genera un gradiente de potencial tanto del lado de la disolución como del lado sólido (Figura 5). Sobre el semiconductor se forma una doble capa cargada (capa de Helmholtz y de Gouy-Chapman) ya sea por adsorción de iones o moléculas, por dipolos orientados o por la formación de enlaces superficiales entre el sólido y las especies en disolución. Las cargas expuestas en el semiconductor no están localizadas solamente en el plano de la interfase, sino que se distribuyen a lo largo de una distancia finita hacia el interior del semiconductor (región de carga espacial).



Figura 5. Esquematización de una interfase semiconductor-electrolito. La interfase se puede dividir en tres zonas: la región de carga espacial en el semiconductor, la región de Hemholtz entre el sólido y el plano externo de Hemholtz (OHP), y la región de Gouy Chapman en la solución.

Cuando el semiconductor se pone en contacto con la disolución acuosa, un fenómeno de transferencia de carga espontánea a través de la interfase tiene lugar con la finalidad de igualar el nivel de Fermi E_F del semiconductor y el potencial redox de la

solución E_{Fredox} [1]. En consecuencia, tanto el nivel de Fermi del sólido, como las bandas de valencia y de conducción se curvan.

Para un semiconductor tipo n, la curvatura (o doblamiento de bandas) tiene lugar como lo indica la Figura 6 debido a que la transferencia de los portadores mayoritarios (electrones) es promovida hacia la disolución, generándose una *región de agotamiento*. En caso contrario, cuando la transferencia de carga promueve una acumulación de portadores mayoritarios, se forma una *región de acumulación* y las bandas se curvean en sentido contrario al caso anterior.



Figura 6. Diagrama de energía de un semiconductor tipo n en contacto con un electrolito, W es la extensión de la región de la carga espacial, $\Delta \varphi_0$ es el potencial en la superficie. La barrera de potencial, $\Delta \Phi(x)$, sólo depende de las posiciones iniciales de E_C y E_{F,redox}, y es independiente de la concentración de impurezas del material finalmente $\Delta \Phi_S$ es la barrera superficial.

En este contexto, es necesario resaltar que el doblamiento de bandas es físicamente significativo para semiconductores másicos porque este fenómeno depende predominantemente del potencial eléctrico aplicado a la interfase [8]. De esta forma, la caída de potencial que caracteriza a este doblamiento en la región de carga espacial $\Delta \phi_0$ es expresado por la Ecuación 9 [9], donde k_B es la constante de Boltzmann, T es

la temperatura absoluta, L_D es la longitud externa de Debye y w es la región de la carga espacial que a su vez es función del potencial de banda plana E_{fb} y aplicado E, respectivamente, así como de la concentración de sitios donadores de electrones N_D [9].

$$\Delta \Phi_0 = \frac{k_B T}{2e} \left(\frac{w}{L_D}\right)^2 \tag{9}$$

$$w = \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_0(E - E_{fb})}{eN_D}} \tag{10}$$

En el caso de semiconductores nanoparticulados no se observa doblamiento de bandas debido a los llamados fenómenos de confinamiento cuántico que a continuación se detallan (Figura 7).



Figura 7. Formación de la región de carga espacial para partículas de tamaño (a) submicrométricas de tipo n y, (b) nanométricas, ambas en equilibrio con una disolución electrolítica que contiene un par redox con el nivel de Fermi E_F . En la partícula nanométrica el doblamiento de bandas es despreciable.

1.5 Semiconductores nanoparticulados

Los semiconductores másicos y nanoparticulados están hechos del mismo material, sin embargo la característica principal de estos últimos es el tamaño de las partículas que lo conforman, ya que se encuentran en el orden de nanómetros, mientras que los másicos están conformados por partículas submicrométricas.

Desde el punto de vista de la teoría clásica de semiconductores másicos, se entiende que las propiedades electrónicas de un semiconductor son independientes del tamaño del cristal. No obstante, estudios recientes han demostrado que cuando el tamaño de partícula de los semiconductores es menor a 20nm, sus propiedades fisicoquímicas son sustancialmente diferentes a las propiedades de un semiconductor másico [10]. Por ejemplo, su estabilidad termodinámica a pesar de que se emplean áreas superficiales extremadamente grandes (factores de rugosidad próximos a 1000).

Cuando el material semiconductor es de tamaño nanométrico, la teoría de bandas de los semiconductores cristalinos debe adaptarse a una hipótesis en la que el cristal del material nanoparticulado es finito, ya que el número de átomos en los materiales nanocristalinos llega a ser inferior a los de materiales másicos en varios miles. Como consecuencia a este fenómeno, la extensión del solapamiento de los orbitales atómicos disminuye, por lo tanto las bandas de energía se adelgazan [10].

Las diferencias en las propiedades electrónicas que existen entre los semiconductores másicos y los nanoparticulados pueden ser descritas por la distribución del potencial en la interfase del lado del semiconductor. Este tratamiento matemático ha sido estudiado por Albery y Bartlett [11], basándose en la linearización de la ecuación de Poisson-Boltzmann.

Entonces, a diferencia de potencial entre el centro de una partícula (r=0) y una distanica r está dada por la Ecuación 11 donde $\Delta \Phi_0$ es la caída de potencial en la región de la carga espacial *w*, *k* es la constante de Boltzmann, r_0 es el radio de la

15

partícula, *r* es la distancia medida partiendo desde el centro de la partícula, *T* es la temperatura absoluta, *e* es la carga del electrón y L_D es la longitud de Debye que depende de la concentración de dopantes N_D así como de la constante dieléctrica del semiconductor ε , siendo ε_0 la permitividad en el vacío [4].

$$\Delta \Phi_0 = \frac{kT}{6e} \left(\frac{r - (r_0 - w)}{L_D} \right)^2 \left(1 + \frac{2(r_0 - w)}{r} \right)$$
(11)

$$L_D = \left(\frac{\varepsilon \varepsilon_0 kT}{2e^2 N_D}\right)^{0.5} \tag{12}$$

Por lo tanto, al alimentar la ecuación 12 en la 11, podemos definir un valor de la caída de potencial en la región de carga espacial como sigue:

$$\Delta\Phi_0 = \frac{kT}{6e} \left(\frac{r_0}{L_D}\right)^2 \tag{13}$$

1.6 Heteroestructuras semiconductoras

Una heteroestructura es la unión de dos semiconductores distintos [12]. Cuando esta unión tiene lugar, el alineamiento de los niveles de Fermi de ambos materiales (equilibrio eléctrico) se manifiesta en un desalineamiento de las bandas de conducción y de valencia de los semiconductores (Figura 8).



Figura 8. Generación de una heteroestructura semiconductora. (a) Los semiconductores aislados tienen bordes prohibidos de absorción diferentes ($E_{g1,2}$) y dopaje distinto; (b) al ponerlos en contacto las bandas interaccionan promoviendo un desacople de bandas característico ($\Delta E_C y \Delta E_V$); (c) para garantizar la neutralidad eléctrica del material un fenómeno transferencia de huecos y/o electrones conduce a que el nivel de Fermi sea el mismo entre ambos materiales.

Particularmente, el Cu₂O es un semiconductor que, una vez soportado en TiO₂, crea un nanocomposito que ha demostrado tener diversas aplicaciones, entre las que destacan: oxidación fotocatalítica [13], fotoelectrocátalisis [14], celdas fotovoltaicas [15,16] y como electrodos en baterías [17].

No obstante, desde el punto de vista sintético, las películas nanoestructuradas de unión tipo TiO₂/Cu₂O presentan una problemática compleja debido a que los equilibrios electro- y químicos del cobre presentan una dependencia muy fuerte con los niveles de acidez. En el siguiente capítulo se explicará con detalle esta problemática.

Capítulo 2

Técnicas y problemática relacionadas con el depósito de películas de Cu₂O y de los materiales dendríticos como complejantes de iones Cu(II)

1. Generalidades sobre el Cu₂O

El Cu₂O es un óxido de color rojizo. En la naturaleza se encuentra típicamente como el mineral cuprita, que posee una red cristalina cúbica centrada en las caras (Figura 9).



Figura 9. Estructura cristalina del Cu₂O.

El Cu₂O es un semiconductor no estequiométrico típicamente de tipo p con un bandgap de 2.0 eV. Sin embargo, numerosas publicaciones demuestran que puede poseer también un comportamiento de tipo n [18,19].

Debido a su bajo costo de producción, baja toxicidad y propiedades de absorción de luz solar, este óxido es considerado como material semiconductor para aplicaciones tales como

- Dispositivos fotovoltaicos [15, 16]
- Material fotocatalítico [13] y fotoelectrocatalítico [14]
- Electrodos de baterías [17]

La ventaja de ser empleado en procesos fotoquímicos y/o fotoelectroquimicos, se debe a que posee un alto coeficiente de absorción en la región visible (≈1000cm⁻¹ a 600 nm).

No obstante, se ha observado repetidamente que el Cu₂O tiende a fotoreducirse a Cu metálico, volviendo ineficientes los fotoprocesos en los que se le involucra [20].

1.1 Procesos de descomposición fotoasistida en semiconductores

La fotoactivación de un semiconductor genera la producción de pares electrón-hueco. Bajo esta situación, la factibilidad termodinámica de que un proceso de descomposición fotoasistida tenga lugar en el semiconductor, depende de la posición relativa de los niveles de Fermi del material y de los pares redox contenidos en disolución [1].

En este contexto, los casos posibles de fotodescomposición que puede presentar un semiconductor son esquematizados en la Figura 10. En este escenario, la fotocorrosión espontánea de dichos materiales tendría lugar solo cuando la descomposición anódica o catódica sean simultáneamente favorables (Figura 10b). En caso contrario, el semiconductor puede ser estable termodinámicamente (Figura 11a), o bien sufrir sólo reacciones de foto-oxidación (Figura 10c) o de foto-reducción (Figura 10d).



Figura 10. Procesos de descomposición fotoasistida en un semiconductor: (a) material termodinámicamente estable, (b) material inestable anódica y católicamente (fotocorrosión), (c) material inestable anódicamente y (d) material inestable catódicamente.

Desde un punto de vista cinético, los materiales semiconductores estables frente a la fotocorrosión son aquellos en los que los sitios catódicos y anódicos del sólido son rápidamente regenerados por especies aceptoras o donadoras de electrones en estrecha interacción con éstos.

2. Técnicas de depósito de Cu₂O

El Cu₂O ha sido preparado en forma de láminas delgadas a través de un gran número de técnicas, las más usuales se describen a continuación.

2.1 Spray pirólisis

Esta técnica consiste en hacer incidir, sobre un sustrato previamente calentado a una temperatura adecuada, un spray conformado por un gas portador (inerte al sistema) y la disolución que contiene la sustancia a depositar. Esta última proporciona la película deseada al descomponerse sobre la superficie del sustrato. Para lograr este proceso, se deben emplear sustancias que se descompongan a temperaturas relativamente bajas y que no dejen otro residuo sólido más que el que debe formar la película. Para obtener películas de óxidos, son muy empleados los acetatos de diferentes cationes (entre ellos los de Cu²⁺). Es un método económico y rápido, pero tiene el inconveniente de que requiere el control preciso de muchas variables tales como concentración, flujo, altura del spray, temperatura del sustrato, entre otras [21].

2.2 Depósito químico en fase vapor

La técnica de depósito en fase vapor (CVD, por sus siglas en inglés *Chemical Vapor Deposition*) involucra un proceso químico específico para depositar capas delgadas de diversos materiales como el Cu₂O [22]. Esta técnica consiste en la reacción de una mezcla de gases en el interior de una cámara de vacío para dar lugar a la formación de un material de capa delgada. Se producen frecuentemente subproductos volátiles, que
son evacuados por medio de un flujo de gas que pasa a través de la cámara de reacción (Figura 11).



Figura 11. Esquema del sistema para el depósito químico en fase vapor (CVD)

2.3 Pulverización catódica o sputtering

Esta técnica se basa en el bombardeo de un cátodo con iones positivos obtenidos por ionización de un gas en una atmósfera de plasma y un campo eléctrico intenso [23]. Los átomos del gas cargado positivamente inciden sobre el blanco (donde se encuentra el material a depositar), provocando que los átomos que constituyen su material sean arrancados y dirigidos hacia el sustrato donde se depositan (Figura 12).

El campo eléctrico implicado en el proceso desvía los electrones confinándolos en la proximidad de la superficie del blanco dando lugar a dos efectos importantes: disminución del calentamiento del sustrato debido a los electrones y aumento considerable de la ionización del gas en la superficie del cátodo, eventos que redundan en un incremento de la velocidad de pulverización. De esta forma, cuando el proceso transcurre en presencia de un gas inerte (pulverización no reactiva), los depósitos que se obtienen son del mismo material que compone el blanco.





2.4 Electrodepósito o depósito electroquímico

A diferencia de los métodos antes citados, la técnica de electrodepósito presenta como ventaja más importante el que se lleva a cabo en disoluciones generalmente acuosas, las cuales permiten trabajar a presión y temperaturas ambientales. Bajo estas circunstancias, el depósito tiene lugar por oxidación o reducción de los iones presentes en el baño electrolítico en contacto con la superficie del electrodo. El electrodepósito permite de esta forma la obtención de capas de espesor controladas como función de la densidad de corriente o del potencial aplicado al sistema electroquímico según lo fije el usuario.

2.4.1 Fundamentos básicos de la técnica de electrodepósito

El electrodepósito se produce aplicando una densidad de corriente o potencial eléctrico adecuados entre un electrodo de trabajo y otro auxiliar ambos sumergidos en una disolución electrolítica. Esta modalidad de perturbación provoca que sobre uno de los electrodos ocurra la reacción de reducción del catión metálico de interés a su estado reducido en forma de una película.

El depósito electroquímico es una técnica que recientemente ha retomado fuerza en virtud de que ha sido utilizada para la obtención de películas de materiales

nanométricos con propiedades muy diversas, entre las que destacan las semiconductoras y las magnéticas. Dentro de las ventajas que ofrece este método se encuentran el empleo de bajas temperaturas limitada solo por el punto de ebullición del electrolito, control de la cinética del proceso a través de la corriente que circula en la celda, así como un control termodinámico por imposición del potencial aplicado [24].

2.4.2 Antecedentes del electrodepósito de Cu₂O

El Cu₂O ha sido electrodepositado sobre sustratos tales como Cu, Ni, Ti, acero inoxidable y electrodos óptimamente transparentes (OTE, por sus siglas en inglés *Optically Transparent Electrodes*) empleando comúnmente el modo potenciostático. Los numerosos trabajos de investigación publicados a la fecha muestran un estudio exhaustivo de la influencia de los distintos parámetros de electrodepósito (como pH del baño electrolítico y concentración del catión metálico precursor) sobre el comportamiento fotoelectroquímico (tipo p ó n) del Cu₂O (18,25-33).

2.4.3 Comportamiento tipo p y n del Cu₂O y su relación con vacancias de cobre y de oxígeno.

La síntesis de Cu₂O con características eléctricas apropiadas es importante por su utilidad en diversos dispositivos [33,34]. En este sentido, ha sido reportado que la obtención de Cu₂O tipo p (p-Cu₂O) se favorece mediante concentraciones altas de Cu²⁺ en un medio alcalino [18,26-29]. De acuerdo con el mecanismo aceptado en la literatura, en el primer paso de reacción (Reacción 14) se efectúa la reducción de los iones Cu²⁺ a Cu⁺ en la superficie del electrodo, mientras que en el segundo paso (Reacción 15) el Cu₂O es formado concertadamente vía la reacción química del ion Cu⁺ con iones OH⁻. Bajo estas circunstancias, la conductividad tipo p del Cu₂O está asociada a vacancias de cobre (V_{Cu}) en su red cristalina (Figura 14A) que establecen un solo nivel aceptor localizado por debajo de su banda de conducción [29].

$Cu^{2+} + e^- \rightarrow Cu^+$	(14)
$2Cu^+ + 2OH^- \rightarrow Cu_2O + H_2O$	(15)

Por otro lado, la obtención de Cu₂O tipo n (n-Cu₂O) se ha visto favorecida si se emplean concentraciones bajas de Cu²⁺ y medio ácido acuoso según la Reacción 16 [29-33]. No obstante, esta vía de síntesis ha sido poco valorada en función de que el proceso de transferencia de carga consecutivo (Reacción 17) conduce a la formación de Cu metálico como producto secundario de la reacción principal.

$$2Cu^{2+} + H_2O + 2e^- \to Cu_2O + 2H^+$$
(16)

$$Cu_2O + 2H^+ + 2e^- \rightarrow 2Cu + H_2O \tag{17}$$

La conductividad del Cu₂O tipo n en contraste con la del Cu₂O tipo p, está determinada por vacancias de oxígeno (V_o) presentes dentro de su red cristalina (Figura 13B), dando lugar en esta ocasión a dos niveles donadores que se localizan, uno por debajo de la banda de conducción y otro por encima de la banda de valencia [35].



Figura 13. Esquema de la red cristalina de Cu_2O tipo p (A) y tipo n (B) mostrando la disposición de vacancias de cobre (V_{Cu}) y de oxígeno (V_O), respectivamente, con respecto a los átomos de Cu (puntos rojos) y los de oxígeno (puntos azules).

La existencia de los niveles aceptores y donadores arriba mencionados ya ha sido demostrada. En este contexto, Bloem y colaboradores demostraron que las vacancias de oxígeno introducen dos niveles en el bandgap del Cu₂O sin poder identificar su naturaleza [36]. Más tarde, Solache-Carranco y col. [35] realizaron un estudio de fotoluminiscencia (FL) de películas de Cu₂O con la finalidad de elucidar la naturaleza de dichas vacancias de oxígeno. Los espectros de fotoluminiscencia de la Figura 14 indicaron que la presencia de una banda de emisión en 720nm se asociaba a la presencia de vacancias de oxígeno doblemente ionizadas (V_O²⁺), mientras que una segunda banda de emisión localizada en 810nm está relacionada con la presencia de vacancias de oxígeno monoionizadas (V_O⁺). Adicionalmente, una tercera banda de emisión se destaca hacia 920nm, indicando la presencia de vacancias de cobre (V_{Cu}).



Figura 14. Espectros de Fotoluminiscencia obtenidos entre 30 y 180 K para una muestra de Cu₂O, previamente publicados en la referencia [19].

En concordancia con los resultados previamente discutidos, se ha reportado que las vacancias de cobre (V_{Cu}) en Cu₂O tipo p se localizan energéticamente (Figura 15) en ~0.4eV por encima de la banda de valencia [29], mientras que para Cu₂O tipo n, las

posiciones de las vacancias mono- (V_0^+) y doblemente (V_0^{2+}) ionizadas fueron determinadas en ~1.3 y 1.1eV por debajo de la banda de conducción, respectivamente.

3. Energética de las superficies de TiO₂/p-Cu₂O y TiO₂/n-Cu₂O

El acoplamiento de las heterouniones $TiO_2/p-Cu_2O$ (Figura 15A) ó $TiO_2/n-Cu_2O$ (Figura 15B) con el par redox I_3 |l⁻ resulta ser muy atractivo porque representa una forma alternativa en la construcción de dispositivos enfocados a la transducción de energía química en electricidad en ausencia de fotoactivación [18,20,37] como por ejemplo, una pila primaria [17].

En función de la discusión realizada en la sección 2.4.3 y del diagrama energético de la Figura 15 construido con información de la literatura, resulta razonable inferir que los ánodos de Cu₂O tipo p (Figura 15A, conteniendo un gran número de vacancias de cobre), serían más aptos que los de Cu₂O tipo n (Figura 15B, conteniendo una gran cantidad de vacantes de oxígeno V₀⁺ y V₀²⁺) para su aplicación en la construcción de pilas primarias. Esto se debe a que en ausencia de fotoactivación, la teoría de semiconductores predice que mientras los semiconductores extrínsecos de tipo p tienen un marcado comportamiento anódico, los semiconductores extrínsecos de tipo n exhiben un predominante comportamiento catódico. En consecuencia, películas de p-Cu₂O deberían satisfacer la diferencia $\Delta \phi^{\circ}(I_3 | \Gamma) - \Delta \phi^{\circ}_{ox} > 0$ en mejor medida que las de n-Cu₂O. No obstante, para que la brecha energética entre ambos pares redox sea cada vez más positiva, es necesario optimizar la cantidad de Cu^o producido por la Reacción 17 durante la electroformación de Cu₂O en medio ácido (Reacción 16).

CAPITULO 2 Técnicas y problemática relacionadas con el depósito de películas de de Cu₂O y materiales dendríticos como complejantes de iones Cu(II)



Figura 15. Diagramas energéticos predictivos para pilas primarias ensambladas con ánodos de (A) TiO₂/p-Cu₂O en y (B) TiO₂/n-Cu₂O acoplados con el par redox I_3^{-1} como semireacción de reducción [18,20,37,38]. Los símbolos E_{bv}, E_{bc} y E_F indican energías de banda de valencia, de banda de conducción y de nivel de Fermi, respectivamente.

Con la intención de minimizar la reacción de electroformación de Cu, la estrategia planteada en este trabajo consistió en amortiguar tanto el pH del seno de la disolución como el interfacial. Mientras que el pH de la disolución se amortigua con un buffer tradicional, en el caso del pH interfacial este se podría amortiguar funcionalizando

químicamente la superficie del sustrato de electrodo con materiales orgánicos ricos en grupos que posean propiedades ácido-base.

4. Materiales dendríticos

Los dendrímeros son macromoléculas poliméricas sintéticas tridimensionales que pueden visualizarse como micelas unimoleculares en las que se distinguen tres partes estructurales principales (Figura 16): (a) el núcleo, que actúa como centro inicial de crecimiento generacional y confiere propiedades de tamaño, forma, multiplicidad y funcionalidad especifica; (b) el interior, que cuenta con propiedades endorreceptoras y confiere propiedades de flexibilidad y topología; y (c) el exterior o periferia, que promueve propiedades exorreceptoras y de reactividad química frente al medio con el que tenga contacto [39].



Figura 16. Componentes estructurales de los dendrímeros, siendo *z* el grupo funcional de la superficie del dendrímero con propiedades exorreceptoras.

El crecimiento sintético del dendrímero (Figura 17) se produce generación tras generación a partir del núcleo central vía ramificación en una serie de etapas repetitivas de adición y activación que multiplica rápidamente el número de grupos funcionales periféricos [40].

CAPITULO 2 Técnicas y problemática relacionadas con el depósito de películas de de Cu₂O y materiales dendríticos como complejantes de iones Cu(II)



Figura 17. Esquema del crecimiento generacional de las ramificaciones de un dendrímero donde G0, G1, G2, G3 y G4 indican la generación de la estructura polimérica.

4.1 Dendrímeros de tipo poliamidoamina

Los dendrímeros de poliamidoamina (PAMAM) constituyen nanosistemas poliméricos con propiedades singulares caracterizados por una mínima dispersión de tamaño y estructura superficial bien definida (Figura 18), la principal característica es la naturaleza química de los monómeros y después el núcleo, esta combinación define la estructura, tamaño, dispersión y propiedades endo- y exo-receptoras. Los grupos funcionales en la superficie de esta clase de dendrímeros pueden ser grupos amino (NH₂) o carboxilo (COOH) [40].

Cuando se trata de los grupos NH₂ se denominan dendrímeros de generaciones enteras (G0, G1, G2,..., Gn) y cuando los grupos terminales son carboxilos se denominan dendrímeros de generaciones fraccionarias (G0.5, G1.5, G2.5,..., Gn.5).



Figura 18. Estructura química de un dendrímero PAMAM generación 2.5.

De esta forma, el número de grupos periféricos y el peso molecular de estas moléculas se incrementan progresivamente con cada generación, constituyendo factores que determinan la topología de estos materiales (Figura 19).



Figura 19. Topología de los dendrímeros PAMAM de generaciones 0, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 y 6.5.

4.2 Propiedades ácido-base y complejantes de los dendrímeros PAMAM frente a los iones Cu(II)

Las aplicaciones de los dendrímeros son numerosas, alcanzando no sólo el campo de la química y ciencia de materiales, sino también de la biología y de la medicina. Los dendrímeros pueden formar películas sobre la superficie de electrodos con un espesor bien definido. Las películas formadas de esta manera son estables y pueden ser utilizadas en procesos electrocatalíticos o en reacciones de transferencia electrónica [41]. Por ejemplo, en nuestro grupo de investigación se ha demostrado que los dendrímeros PAMAM con terminaciones carboxiladas o aminadas confieren un carácter amortiguador a las superficies que los contienen de manera que pueden ser empleados para amortiguar el pH interfacial [42].

Diversas investigaciones han demostrado que los dendrímeros PAMAM pueden forman complejos muy estables con el Cu²⁺ en medio acuoso [43-45]. En este sentido M.S. Diallo y col. [45] reportaron que los dendrímeros PAMAM G8 (terminación aminada) pueden complejar hasta 153±20 iones Cu(II) por molécula dendrítica, mientras que un dendrímero PAMAM G4 compleja 13±1 iones Cu(II) por molécula.

Por otro lado, en el caso de dendrímeros PAMAM con terminación carboxilada, se ha reportado que la naturaleza de dichos complejos depende de la región del dendrímero que interaccione con los iones de Cu(II) (Figura 20). Por ejemplo, M.F. Ottaviani y col. reportaron estudios de resonancia paramagnética de electrón (RPE) enfocados a la caracterización de los tipos de complejos formados entre iones de Cu²⁺ y dendrímeros PAMAM carboxilados. Con base en la Figura 21, los resultados de estos investigadores indicaron que la estructura de los complejos formados dependió fundamentalmente de las condiciones de pH del medio y de la generación dendrítica [43]. En consecuencia, para el caso del medio electrolítico empleado en nuestro trabajo (buffer de acetatos pH4.5) y dendrímero PAMAM generación 3.5, la Tabla insertada en la Figura 21 predice la formación de complejos del tipo (c).



Figura 20. Representación esquemática de los tipos de complejos formados entre los dendrímeros PAMAM y el Cu²⁺: (a) externos, b) internos y (c) externos/internos.



Figura 21. Complejos del dendrímero PAMAM G n.5 con el Cu²⁺ a valores de pH a) intermedios, b) alcalinos y c) ácidos.

Con base en lo anterior, se puede inferir que la funcionalización de películas de TiO₂ con dendrímeros PAMAM que contengan una periferia carboxilada, pudieran ser empleados como amortiguadores interfaciales del pH, siempre y cuando la selección del pK_a de los grupos con propiedades ácido-base de la periferia sea la más adecuada. De esta forma, la electroformación bien controlada de Cu° (Reacción 17) durante el electrodepósito de películas de Cu₂O (Reacción 16) podría ser realmente alcanzada. Complementariamente, las propiedades coordinantes de los dendrímeros pudieran conducir a la preconcentración interfacial de iones Cu²⁺ incrementando el rendimiento farádico de la reacción de electrodepósito del Cu₂O (Reacción 16).

Capítulo 3

Obtención y caracterización de electrodepósitos de Cu₂O sobre electrodos nanoestructurados de TiO₂ modificados con dendrímeros de poliamidoamina

1. Electrodos nanoestructurados de TiO₂

Entre los métodos de síntesis que existen para preparar películas de TiO_2 , el depósito electroforético (EPD) presenta grandes ventajas ya que permite controlar no sólo parámetros estructurales como grosor, porosidad y área superficial, sino también la composición de la película. En este contexto, dos o más tipos de materiales semiconductores pueden depositarse sucesivamente sobre el mismo substrato [46].

1.1 Fundamentos del método de depósito electroforético

El depósito electroforético es una metodología ampliamente utilizada para confinar suspensiones coloidales de corte metálico y cerámico en forma de películas delgadas sobre un substrato. El requisito fundamental para que ocurra el depósito electroforético es que las partículas en suspensión posean carga eléctrica.

En este contexto, una partícula en suspensión que esté cargada superficialmente, se encuentra rodeada por iones de carga opuesta (contraiones) y en una concentración mayor que en el seno de la disolución. Esta atmósfera iónica que envuelve a la partícula cargada se conoce como doble capa eléctrica y es caracterizada por un potencial interfacial conocido como potencial zeta o electrocinético. De esta forma, cuando se aplica un campo eléctrico, los contraiones y las partículas tendrían que moverse en direcciones opuestas, sin embargo, como los contraiones se encuentran unidos electrostáticamente a las partículas, una fracción de los mismos se desplazará con ella a una velocidad definida como movilidad electroforética [47].

Los componentes de una celda electroforética (Figura 22) típicamente son: (a) suspensión coloidal en un disolvente adecuado, (b) superficie conductora donde se llevará a cabo el depósito electroforético, (c) contraelectrodo y (d) fuente poder que permita imponer a la celda un potencial o una corriente constante [48].

37



Figura 22. Esquema de una celda para llevar a cabo el crecimiento de películas mediante depósito electroforético en un régimen potenciostático.

De acuerdo con la Relación 18, el crecimiento electroforético de películas en modo potenciostático está basado en el cambio instantáneo de la masa de la película dm/dt (kg/s) como función de la intensidad del campo eléctrico κ (V/m), donde μ (m²/V·s) es la movilidad electroforética de las partículas coloidales, C (kg/m³) es la carga de las partículas en suspensión y A (m²) es el área del electrodo a recubrir). Asimismo, φ es el factor que toma en cuenta que no todas las partículas alcanzan la superficie del electrodo y son incorporadas en la película.

$$\frac{dm}{dt} = \varphi \mu \kappa C A \tag{18}$$

Con base en las ventajas que ofrece el método de depósito electroforético, películas de TiO₂ fueron crecidas sobre sustratos de titanio metálico empleando esta técnica.

1.2 Obtención de películas nanoestructuradas de TiO₂ sobre láminas de Ti

1.2.1 Metodología experimental

Nanopartículas de TiO₂ coloidal (21nm de diámetro) fueron utilizadas para obtener películas nanocristalinas sobre láminas de titanio, previamente devastadas con arena (sandblastting, norma ASTM D2651-01) con la finalidad de obtener una mayor rugosidad superficial. Posteriormente y antes de realizar el depósito electroforético, las láminas de titanio fueron limpiadas sumergiéndolas sucesivamente en HNO₃ 10%, HCl 10% y finalmente en NaOH 1M etanólico durante 10 min [48].

Acto seguido, el depósito electroforético se llevó a cabo en una celda manufacturada en paredes de acrílico (Figura 23) que contenía una suspensión coloidal de 0.5g de TiO₂ por cada 10mL de alcohol isopropílico al 5% v/v en agua (previamente sonicada durante 15 min.). De esta forma, una tensión eléctrica de 4V fue aplicada entre dos placas, la de titanio (cátodo) y una de acero inoxidable (ánodo), ambas sumergidas en la suspensión coloidal. La separación efectiva entre placas fue de 2cm, por lo tanto el campo eléctrico aplicado fue de 2V/cm.



Figura 23. Celda electroforética empleada para la obtención de los electrodos nanoestructurados de TiO₂.

Las películas obtenidas a diferentes tiempos de depósito electroforético fueron sinterizadas (Figura 24) a 450°C en aire durante 30 minutos [49] con la finalidad de otorgarle estabilidad mecánica y conectividad eléctrica interpartículas. Posteriormente fueron estudiados morfológicamente mediante imágenes obtenidas con un microscopio óptico (Olympus BH-2 acoplado a una cámara modelo YC-05 II controlada con el software Wire Video Viewer versión 1.3.30).

Las propiedades ópticas de las películas fueron evaluadas mediante espectroscopia UV-Vis (equipada con un módulo de reflectancia difusa) y espectroscopia de fotocorriente (PS) empleando una celda de cuarzo irradiada con una lámpara de Xe de 100 W modelo 6257, y un monocromador modelo 77250 (ambos Thermo Oriel).

Por otro lado la caracterización estructural de las películas fue llevada a cabo mediante Difracción de Rayos X (XRD) usando un difractómetro Bruker-AXS D8 Advance equipado con un tubo de Cu K α (λ =1.5406 Å).



Figura 24. Esquematización de la secuencia de modificación del sustrato de titanio con TiO_2 nanoparticulado. (a) Superficie de Ti sin modificar, (b) película de TiO_2 electroforéticamente formada sobre el sustrato de Ti, y (c) película de TiO_2 sinterizada.

El área electroactiva A de cada película fue determinada de acuerdo con la Relación 19 donde $Q_H (\mu C)$ y $Q_{H^*} = 219 \mu C/cm^2$ corresponden a la carga de electroadsorción parcial (Reacción 20) y de una monocapa de átomos de hidrógeno sobre el TiO₂, respectivamente.

$$A = \frac{Q_H}{Q_{H^*}} \tag{19}$$

 Q_H fue estimada a partir de voltamperometría cíclica (VC) en una disolución de H₂SO₄ 0.1M en medio acuoso (Figura 25), contenida en una celda de tres electrodos donde un electrodo de AglAgCl sat KCl y un alambre de platino funcionaron como electrodo de referencia y contraelectrodo, respectivamente.

$$TiO_2 + H^+ + e^- \rightarrow TiOOH$$
(20)

Figura 25. Voltamperograma cíclico correspondiente a la electroadsorción de H en H₂SO₄ 0.1M hacia 0.65V, empleado para calcular el área electroactiva de películas obtenidas mediante EPD (para 100s de depósito en este caso).

Posteriormente el factor de rugosidad η , fue calculado a partir del área geométrica A_G y electroactiva A según la siguiente relación:

$$\eta = \frac{A}{A_G} \tag{21}$$



El análisis de los datos (Figura 26-I) indica que la carga de electroadsorción de H aumenta rápidamente a partir de tiempos de depósito electroforético superiores a 200s, sugiriendo que el área electroactiva también incrementa. En comparación, la Figura 26-Il muestra que el factor de rugosidad alcanza valores máximos y constantes hacia los 300s de depósito electroforético en concordancia con la forma de la Figura 26-I.



Figura 26. Carga de hidrógeno electroadsorbido (A) y factor de rugosidad estimado (B) estimados para películas nanoestructuradas de TiO₂ obtenidas como función del tiempo de depósito electroforético (t).

1.4 Resultados y discusión

1.4.1 Microscopia óptica

La textura de las películas de TiO₂ obtenidas vía EPD fue evaluada mediante imágenes obtenidas con microscopia óptica (Figura 27) a los diferentes tiempos de depósito (desde 0-540s en intervalos de 20s). Una comparación de las imágenes obtenidas demuestra que mientras la morfología de las películas formadas no depende sustancialmente del tiempo de depósito, un tiempo mínimo de 40s es necesario para generar películas semiconductoras que recubran en su totalidad al sustrato original.

Por otro lado, una inspección más detallada de las imágenes demuestra que hasta los 100s de depósito existe un mínimo efecto de agrietamiento.





Figura 27. Imágenes obtenidas por el microscopio óptico para (a) lámina de titanio y películas de TiO₂ preparadas a tiempos de depósito de (b) 20, (c) 40, (d) 60, (e) 80, (f) 100, (g) 120, (h) 140, (i) 160, (j) 180, (k) 200, (l) 220, (m) 240, (n) 300, (o) 360, (p) 420, (q) 480 y (r) 540s.

Con la finalidad de conocer las propiedades ópticas de las películas de TiO₂, se llevaron a cabo experimentos de espectroscopia UV-Vis en modo reflectancia difusa y de espectroscopia de fotocorriente para una muestra representativa de películas de este óxido semiconductor.

1.4.2 Difracción de Rayos X (XRD)

Mediante el análisis de XRD fue posible identificar las fases cristalinas características del TiO₂ para cada grosor de película. De esta forma, los difractogramas compilados en la Figura 28 indican la presencia de dos fases cristalinas, anatasa (denotada como A) y rutilo (denotada como R), concordando con resultados previos ya reportados por nuestro grupo de investigación [49].

CAPITULO 3 Obtención y caracterización de electrodepósitos de Cu₂O sobre electrodos nanoestructurados de TiO₂ modificados con dendrímeros de poliamidoamina



Figura 28. Difractogramas de rayos X para las películas de TiO₂ sobre sustratos de Ti a diferentes tiempos de depósito electroforético: (a) 100, (b) 240, (c) 330 y (d) 420s.

1.4.3 Reflectancia difusa y espectroscopia de fotocorriente

Espectros de absorción para las películas de TiO₂ crecidas a 100, 240, 330 y 420s son mostrados en la Figura 29y más tarde convertidos a curvas tipo Tauc (Figura 30) con la finalidad de estimar su bandgap óptico [48] en la zona donde las líneas discontinuas interceptan al eje de energía (hv) en apego a la relación 22.

$$(KM \times hv)^{0.5} \propto \left(hv - E_g\right) \tag{22}$$



Figura 29. Espectros de absorción obtenidos para películas de TiO_2 crecidas a tiempos de depósito electroforético de (a) 100, (b) 240, (c) 330, y (d) 420s. Las intensidades de los espectros son expresados como coeficiente Kubelka-Münk (KM).

Una inspección comparativa de las Figuras 30-a y 30-b con las Figuras 30-c y 30-d demuestra un efecto de dopado gradual por efecto de átomos de Ti(III) electrogenerados en la estructura cristalina del TiO₂ durante el EPD (Reacción 23) [49]. Este evento genera nuevos niveles energéticos justo en la zona de banda prohibida, los cuales se han identificado como vacantes de oxígeno V_O (Ti^{III}-V_O-Ti^{III}) o dopantes intersticiales Ti^{III} (Ti^{III}-(Ti^{III})-Ti^{IV}). Este fenómeno es soportado experimentalmente por un corrimiento rojo (de 3.2 hasta 2.9 eV) en términos de los valores de bandgap para las películas de TiO₂ estudiadas [49].

$$TiO_{2} + \chi H^{+} + \chi e^{-} \to [\chi Ti^{3+}(1-\chi)Ti^{4+}]O_{2-\chi}(OH)_{\chi} \qquad 0 < \chi < 1$$
(23)

CAPITULO 3 Obtención y caracterización de electrodepósitos de Cu₂O sobre electrodos nanoestructurados de TiO₂ modificados con dendrímeros de poliamidoamina



Figura 30. Curvas tipo Tauc para películas de TiO₂ crecidas a tiempos de depósito de (a) 100, (b) 240, (c) 330 y (d) 420s.

Por otro lado, experimentos de espectroscopia de fotocorriente estacionaria permitieron la construcción de espectros de acción en Na₂SO₄ 0.1 M acuoso (Figura 31) para las películas de TiO₂ formadas por depósito electroforético a los mismos tiempos de depósito que los experimentos de UV-Vis reflectancia difusa. La eficiencia de conversión de fotón incidente a corriente (IPCE) fue calculada empleando la Relación 24 con la finalidad de explorar cual película tiene la menor recombinación de portadores de carga fotogenerados.

$$IPCE(\lambda)\% = \frac{1240(V.nm) \times j_{ph}}{\lambda \times I_0}$$
(24)

donde j_{ph} es la densidad de fotocorriente en μ Acm⁻², λ corresponde a la longitud de onda de los fotones incidentes en nm y por último I_0 es la intensidad de la iluminación a cada longitud de onda en Wm⁻².



Figura 31. Espectros de fotocorriente (o de acción) obtenidos para películas de TiO₂ preparadas por EPD durante (a) 100, (b) 240, (c) 330 y (d) 420s de depósito.

El bandgap de las películas de TiO_2 pudo ser estimado a partir de curvas tipo Tauc (Figura 32), que son generadas a partir de los espectros de acción según la Relación 25. De esta forma las curvas indican que los valores de banda prohibida para cada película de TiO_2 son comparables con los obtenidos mediante UV-Vis reflectancia difusa.

$$(IPCE \times h\lambda)^{0.5} = (h\nu - E_g)$$
⁽²⁵⁾

Una inspección de las curvas resultantes IPCE vs λ (Figura 30) y tipo Tauc (Figura 32) demuestra que las películas comienzan a absorber luz en un intervalo de 370-400 nm (3.3-3.1eV) cuya energía de fotoexcitación es característica del TiO₂. Asimismo, un análisis de estas gráficas demuestra que las películas crecidas a 100s exhiben los mejores valores de eficiencia de fotocorriente estacionaria bajo iluminación con fotones de energía mayor al del bandgap del material. De esta forma, las películas con este grosor fueron seleccionadas para las aplicaciones posteriores.



Figura 32. Curvas $(IPCE \times h\lambda)^{0.5}$ para películas de TiO₂ crecidas a tiempos de depósito de (a) 100, (b) 240, (c) 330 y (d) 420s.

1.5 Conclusiones

La generación de películas de TiO₂ nanoparticulado se llevó a cabo exitosamente, indicando que hasta este punto de la investigación ya se contaba con una superficie primaria para efectuar el posterior confinamiento de películas de Cu₂O. En este sentido, los resultados obtenidos en esta primera etapa sugieren la generación in situ de dopantes Ti(III) vía reducción electroquímica de los sitios de Ti(IV), ya que este fenómeno modifica gradualmente el bandgap de las películas de TiO₂ obtenidas vía EPD.

2. Obtención de películas de Cu₂O mediante la técnica de electrodepósito

2.1 Metodología experimental

Con la finalidad de estudiar la electroformación de las películas de Cu₂O sobre una superficie químicamente similar a la de TiO₂ aunque casi plana (factor de rugosidad 1.4, [50]), los electrodepósitos de Cu₂O fueron llevados a cabo sobre un electrodo ópticamente transparente (OTE, por sus siglas en inglés Optically Transparent Electrode), previamente desengrasados con EtOH absoluto.

Dado que el potencial es uno de los parámetros que más afectan la composición química y la microestructura de los materiales depositados electroquímicamente, se estudió en primer lugar la influencia de este parámetro durante el proceso de electrodepósito.

2.1.1 Influencia del potencial aplicado

Con la finalidad de conocer el potencial al cual ocurre el electrodepósito de Cu₂O, se realizaron experimentos de voltamperometría cíclica sobre un OTE sumergido en buffer de acetatos a pH 4.5 (fuerza iónica I=0.3) conteniendo CuSO₄ 0.16mM a una temperatura de 55°C [51]. De esta forma una serie d e potenciales de inversión -10 mV, -75 mV y -230 mV (Figura 33) fueron aplicados a una velocidad de barrido de 10 mVs⁻¹ a partir del potencial de equilibrio (~200mV).

Una inspección de la Figura 33 (potencial de inversión de -230 mV) permite observar dos sobrecruces. El primero está atribuido al depósito de Cu₂O vía la Reacción 16 mientras que el segundo se asocia a la generación de Cu° a partir de la reducción del Cu₂O recién formado (Reacción 17). La obtención de los voltamperogramas a potenciales de inversión de -75 y -10mV soporta este razonamiento, ya que en -75mV solo se observa el sobrecruce correspondiente a la formación de Cu₂O, mientras que para -10mV no se observa ningún sobrecruce.



Figura 33. Efecto de la inversión del potencial sobre la respuesta voltamperométrica de un OTE sumergido en buffer de acetatos pH 4.5 (fuerza iónica, I=0.3) conteniendo $CuSO_4 0.14 \text{ mM} a 55 \text{ C}$. En la zona I, no existe formación de Cu_2O mientras que en la II es obtenido y la zona III corresponde al electrodepósito de Cu^o. En todos los casos la velocidad de barrido fue 10 mVs⁻¹.

Con el objetivo de respaldar la información obtenida de los experimentos de VC, se construyó un diagrama de Pourbaix empleando información de la literatura [52-54] (Figura 34) y bajo las condiciones de trabajo previamente establecidas (55°C, fuerza iónica I=0.3). Las semireacciones 26 a 29 fueron tomadas para este efecto por simplicidad

$Cu^{2+} + e^- \leftrightarrow Cu^+$	(26)
$2Cu^+ + 20H^- \leftrightarrow Cu_20 + H_20$	(27)
$2CuO + 2H^+ + 2e^- \leftrightarrow Cu_2O + H_2O$	(28)
$Cu + H_2O + 2e^- \leftrightarrow Cu_2O + 2H^+$	(29)

En la Figura 34 pueden destacarse sobre la línea vertical punteada cada uno de los potenciales de sobrecruce que aparecen en la Figura 33, indicando que a un pH de 4.5 la formación de Cu_2O es termodinámicamente esperada entre -10 y -50mV vs. Ag|AgCl sat. KCl.



Figura 34. Diagrama de Pourbaix del sistema $Cu^{2+}|Cu = 55$ °C en medio acuoso amortiguado con buffer de acetatos pH 4.5 (fuerza iónica I=0.3).

Con base en estos resultados, se seleccionó preliminarmente un potencial de -50 mV para realizar estudios sobre el efecto que el tiempo de electrodepósito de Cu₂O tendría sobre la calidad cristalográfica de las películas de este material. En este contexto, podemos esperar que mientras el pH del bulto de la disolución se encuentra amortiguado, el interfacial en contraste pudiera estar fluctuando con respecto al tiempo de depósito [42].

2.1.2 Influencia del tiempo de electrodepósito

Los experimentos de electrodepósito sobre OTE fueron llevados a cabo en una celda convencional de tres electrodos (Figura 35), empleando un electrodo de Ag|AgCl sat KCl y un alambre de platino como electrodo de referencia y auxiliar respectivamente, sumergidos en una disolución de CuSO₄ 0.16mM, a una temperatura de 55 °C y pH 4.5 (I = 0.3). El tiempo de electrodepósito fue variado 15, 30, 45, 60, 75, 90 y 120min, mientras que el potencial aplicado se mantuvo en -50mV. Las películas frescas obtenidas a cada tiempo de depósito fueron sinterizadas a 110°C por 5min y posteriormente caracterizadas.



Figura 35. Disposición experimental de la celda empleada para el electrodepósito de películas de Cu₂O.

El grosor de las películas fue determinada mediante perfilometría usando un perfilómetro Stylus Dektak 6M y su caracterización cristalográfica fue evaluada por medio de difracción de rayos X (XRD). El tratamiento de de los difractogramas experimentales fue llevado a cabo con el software *Match! Phase Identification from Powder Diffraction* versión demo 1.7 marca Crystal Impact con la finalidad de analizar la fracción porcentual de cada fase cristalina presente en las muestras.

2.2 Resultados y discusión

2.2.1 Perfilometría

El grosor de las películas de Cu₂O a los diferentes tiempos de electrodepósito fue estudiado. Una comparación de los resultados obtenidos (Figura 36) indica que el

grosor de película no depende sustancialmente del tiempo de depósito ya que los valores de este parámetro oscilan entre 4-6µm.



Figura 36. Perfiles de películas de Cu₂O a los diferentes tiempos de electrodepósito.

2.2.2 Difracción de rayos X (XRD)

Una comparación de los difractogramas (Figura 37), muestra que el electrodepósito de Cu₂O se lleva a cabo sobre OTE. Sin embargo, la relación de intensidades de los picos de difracción asignados a planos cristalográficos relacionados con Cu₂O, no presentan una tendencia bien definida con respecto a la intensidad de los picos de difracción correspondientes a los planos cristalográficos relacionados con Cu[°].

La Figura 38 demuestra que el contenido porcentual en masa de Cu₂O y Cu^o estimado por ajuste computacional mediante el software *Match!*, no tiene una tendencia definida. Este resultado sugiere fuertemente que, tal y como se especulaba, el pH de la interfase OTE/electrolito no se encuentra realmente controlado durante el proceso de depósito.

CAPITULO 3 Obtención y caracterización de electrodepósitos de Cu₂O sobre electrodos nanoestructurados de TiO₂ modificados con dendrímeros de poliamidoamina



Figura 37. Resultados de DRX para películas de Cu₂O electrodepósitadas a potencial constante de -50mV sobre OTE a diferentes tiempos de depósito.



tiempo de electrodepósito / minutos

Figura 38. Porcentajes en masa de Cu_2O y Cu presentes en las películas de Cu_2O a diferentes tiempos de electrodepósito y sus correspondientes porcentajes de empate con el patrón de la base de datos.

Esta página fue eliminada debido a que su contenido es información clasificada como confidencial de acuerdo con el Artículo 113 Fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Capítulo 4

Construcción y evaluación preliminar de dispositivos de transducción de energía química en potencia eléctrica empleando electrodos de TiO₂/Cu₂O

1. Energías alternativas

Recientemente se ha observado que el proceso de sustitución de fuentes de energía eléctrica altamente contaminantes implica la existencia de tecnologías ecológicamente compatibles y rentables, de modo que pueda ser utilizada para activar aparatos y dispositivos electrónicos portátiles con el menor efecto secundario al medio ambiente, una vez que necesiten ser desechados [59]. Desde su descubrimiento, las fuentes de energía eléctrica a partir de la energía química contenida en dispositivos tecnológicos llamados pilas o baterías, constituyen una tecnología ampliamente conocida pero en constante renovación gracias a la proliferación de equipamiento portátil (por ejemplo, celulares, computadoras, reproductores de música, entre otros) [60].

En este sentido y a pesar del buen resultado que proporcionan los sistemas más conocidos con Ni-MH (níquel-hidruro metálico) y Ni-Cd (níquel-cadmio), los problemas de contaminación ambiental generados por el desecho de los metales tóxicos que los constituyen se encuentra en aumento continuo en nuestro país. Esto se debe a que los procesos de reciclado no se encuentran bien establecidos y, para el caso de níquel y cadmio, su recuperación presenta altos costos [10]. Una alternativa viable enfocada a la minimización de este problema consiste en la construcción de pilas y baterías empleando materiales de baja toxicidad para el ser humano y menos contaminantes para el medio ambiente. Recientemente se han estudiado los óxidos de metales de transición M_xO_y (M=Fe, Co, Ni, Cu) para el desarrollo de baterías, comprobándose que estos materiales exhiben buenas características energéticas como ánodos [61].

En virtud de su fácil obtención, reproducibilidad y bajo contenido de Cu^o, las películas de Cu₂O generadas por electrodepósito en este trabajo de tesis fueron probadas preliminarmente como ánodos de pilas primarias.

74

1.2 Pilas y Baterías

Una pila puede definirse como un dispositivo que convierte espontáneamente la energía química proveniente de los materiales electroactivos en energía eléctrica por medio de reacciones electroquímicas de oxidación y reducción [62].

La unidad básica de este sistema se denomina celda o pila, reservando el nombre de batería (Figura 51) a la unión de dos o más celdas (pilas) conectadas en serie con la finalidad de elevar el voltaje o en paralelo para aumentar la corriente. Por ejemplo, en la Figura 51a se muestra que si se asume que cada pila produce 1.5 voltios, entonces 4 baterías en paralelo producirán 1.5 voltios, pero 4 veces más corriente. Por otro lado en un arreglo en serie (Figura 51b), los voltajes individuales de cada pila se suman dando como lugar un voltaje final de 6 voltios, pero la cantidad de corriente es la misma para cada batería.



Figura 51. Arreglo en (a) paralelo y (b) en serie para un conjunto de pilas o celdas.

1.3 Componentes básicos de una pila o elemento

La celda está constituida por componentes básicos tales como electrodos, electrólito, y separadores (Figura 52). Cada uno de estos componentes se describe a continuación.



Figura 52. Componentes básicos de una celda de dos electrodos.

1.3.1 Electrodos

Los electrodos de las pilas suelen ser placas de material electroactivo, el cual debe tener buenas propiedades de conductividad eléctrica, estabilidad química, fácil fabricación, bajo costo, alta eficacia de la reacción electroquímica, baja densidad y una alta área electroactiva [63].

En este sentido (Figura 52), el electrodo positivamente polarizado es el ánodo, y en el ocurre la descarga vía oxidación de la batería en el momento que los electrones son transferidos al circuito exterior. En general puede decirse que cuando la batería se encuentra cargada, el ánodo está formado por especies con bajo estado de oxidación, los cuales se oxidan durante el proceso de descarga. Por otro lado, el electrodo

negativamente polarizado es el cátodo, en el cual ocurre un proceso de reducción vía aceptación de los electrones que provienen del ánodo a través del circuito exterior.

1.3.2 Electrolito

El electrolito es un conductor iónico que permite la transferencia de electrones en el circuito interior por medio de la migración de iones entre el ánodo y el cátodo.

El electrolito debe contar con propiedades importantes tales como:

- Buena estabilidad térmica (baja presión de vapor)
- Alta conductividad iónica
- Bajos efectos corrosivos en los electrodos

1.3.3 Separadores

La función de los separadores es aislar los electrodos evitando el cortocircuito en el interior de la celda y al mismo tiempo permitir el paso indeseado de ciertos iones. En este escenario, los electrodos y los separadores deben ensamblarse adecuadamente para formar lo que se denomina elemento o celda.

1.4 Operación de la celda

Durante el funcionamiento de una pila se da lugar a un proceso químico importante que consiste en la producción irreversible de energía eléctrica durante el proceso de descarga (pila primaria). Si el sistema es reversible, se tendría que contemplar otra operación básica, el proceso de carga, donde por medio de una corriente eléctrica externa se renuevan los materiales de partida (pila secundaria o recargable) [64].

1.4.1 Proceso de descarga

Cuando una batería o celda es conectada a una resistencia externa, se produce un flujo de electrones que van desde el ánodo hacia el cátodo a través del circuito exterior, esto se define como el proceso de descarga. En el ánodo se produce una reacción de oxidación de la materia activa, generándose cationes que emigran a través del electrolito y separador, hacia el electrodo positivo o cátodo. Por otro lado, en el cátodo se produce una reacción de reducción del material activo debido a los electrones que proceden del ánodo. De esta manera se generan aniones que emigran a través del electrólito y el separador hasta llegar al electrodo negativo o ánodo. En todo momento, el principio de electroneutralidad debe cumplirse.

1.4.2 Proceso de carga

En una pila recargable, es posible regenerar los materiales activos transformados durante la descarga a su estado inicial, conectando la celda o batería a una fuente de corriente continua, uniendo el polo positivo y negativo de la fuente al cátodo y ánodo de la pila, respectivamente. Así, se produce un flujo de electrones por el circuito exterior y de iones en el interior de la batería que redunda en un proceso de carga del dispositivo electroquímico.

1.5 Parámetros energéticos característicos de una pila

La cantidad de energía máxima liberada por una batería (potencia máxima), es una característica fundamental de ésta y puede expresarse en función de diversas magnitudes. Todas ellas se basan en la relación de una determinada cantidad de carga con respecto a la cantidad de materia o a las dimensiones del material activo. La utilización de cada una de ellas dependerá del campo de aplicación de la pila. Algunas de las magnitudes más utilizadas son:

1.5.1 Capacidad de carga Q_c

La capacidad de carga informa la cantidad de electricidad que puede almacenarse en el dispositivo voltaico [63]. Dicha magnitud es extensiva y está dada en culombios pero suele expresarse en Ah de acuerdo con la Ecuación 32

$$Q = nzF \tag{32}$$

donde z es el número de moles de la especie activa que participa en una reacción electroquímica concreta, n es el número de electrones transferidos por cada equivalente y F es la constante de Faraday cuyo valor es 96487 C/mol (26800 mAh/mol).

La capacidad de carga es sin lugar a dudas un parámetro útil desde el punto de vista industrial y comercial, pero las perspectivas de un material nuevo se comprenden mejor si es referido a magnitudes intensivas.

1.5.2 Capacidad especifica Q_{esp}

Mediante la capacidad específica se tiene cuantificada la cantidad de electricidad que se puede almacenar por unidad de masa tal y como puede observarse en la Ecuación 33 donde *m* representa la masa del material activo [63].

$$Q_{esp} = \frac{Q}{m} \tag{33}$$

Es importante señalar que muchas aplicaciones de las pilas están enfocadas a la necesidad de movilidad y autonomía de ciertos aparatos de consumo eléctrico (relojes de mano, marcapasos, entre otros), lo que hace importante tener una elevada relación energía/masa.

1.5.3 Energía específica E_{esp}

La energía específica se mide en Wh/kg y está dada por el producto de la capacidad específica y el potencial de salida $\Delta \phi_{ocp}$.

$$E_{esp} = Q_{esp} \Delta \phi_{ocp}$$
 (34)

1.5.4 Potencia específica

A través de este parámetro se tiene conocimiento de la rapidez con el que la energía específicamente almacenada, es extraída del sistema durante un proceso de demanda de corriente *j* al potencial $\Delta \phi$. La potencia específica W_{esp} , se mide en W/kg y está dada por la Ecuación 35 donde *j* representa la corriente de salida.

$$W_{esp} = \Delta \phi j / m \tag{35}$$

1.6 Clasificación de las pilas de acuerdo a la relación carga/descarga

1.6.1 Pilas primarias

Son aquellas que no son susceptibles de recarga y, por tanto, se descargan una sola vez [65]. Las baterías primarias son empleadas para iluminación, equipos de fotografía, dispositivos electrónicos y eléctricos portátiles, entre otros.

La mayoría de los sistemas primarios utilizan un separador absorbente que mantiene el electrolito retenido. Las características más representativas de estas baterías son:

- Baja auto-descarga
- Alta densidad de energía

- Fácil utilización y nulo mantenimiento
- Bajo precio comparado con sistemas recargables equivalentes

En este sentido, la baja auto-descarga de estos sistemas permiten su utilización después de largos períodos de almacenamiento, al contrario de lo que ocurriría con sistemas secundarios, los cuales necesitan de recargas periódicas cuando son almacenados.

1.6.2 Pilas secundarias

Estos sistemas se conocen también como acumuladores, pueden ser recargados eléctricamente después de su descarga hasta alcanzar su condición inicial, para lo cual son conectados a un sistema de carga que genera una corriente eléctrica en dirección opuesta a la descarga [65]. En este contexto, las características más significativas de las baterías secundarias son:

- Buena capacidad para descargar
- Buen comportamiento a bajas temperaturas
- Alta densidad de potencia

2. Construcción y evaluación preliminar de baterías empleando electrodos de TiO₂/Cu₂O

Diversas investigaciones muestran que los óxidos de metales de transición pueden suministrar altos valores de capacidad específica durante el uso cíclico de la pila. Recientemente, se han estudiado varios óxidos de metales de transición como cátodos en batería: FeO, Fe₂O₃, LiFeO₂, Li₅FeO₄, CoO, Co₃O₄, NiO, CuO y Cu₂O [61]. En este sentido, el último objetivo de este trabajo de investigación consistió en preparar películas electrodepósitadas de Cu₂O en sustratos de TiO₂ con la finalidad de que se pueda evaluar su uso potencial como materiales competitivos en el diseño y construcción de pilas.

2.1 Metodología experimental

2.1.1 Ensamblado del dispositivo de transducción de energía electroquímica tipo pila primaria.

El ensamblado de los dispositivos electroquímicos fue llevado a cabo presionando un electrodo de Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O contra un OTE recubierto por una película delgada de PtO_X (OTE/Pt por simplicidad) en una disposición tipo sándwich (Figura 53). Con la finalidad de evitar el cortocircuito del dispositivo un empaque de acetato con un espesor de 160µm fue colocado entre ambos electrodos. El interior de la celda fue llenado con una disolución electrolítica compuesta de carbonato de propileno (PC) + 0.3M Lil + 0.015M l₂. El contra-electrodo de OTE/Pt fue construido esparciendo en la superficie de un OTE, 8μ L/cm² de una disolución de 2-propanol + 10mM H₂PtCl₆. Posteriormente el disolvente se deja evaporar a temperatura ambiente y las superficies así modificadas se calientan a 380°C por 30min. Fin almente, los electrodos se dejan enfriar hasta antes de ser usados. El área geométrica de contacto efectivo entre los ánodos y el electrolito fue de 0.28cm².



Figura 53. Esquema del ensamble de la celda electroquímica de conversión empleada con base en electrodos de Ti/TiO₂/Cu₂O.

2.2. Resultados y discusión

2.2.1 Descarga en régimen estacionario de los dispositivos de transducción de energía química en electricidad

Con la finalidad de averiguar en primera instancia si los dispositivos ensamblados exhibían procesos de almacenaje y conversión de energía, curvas de descarga (j vs E) fueron obtenidas para celdas electroquímicas ensambladas con ánodos de Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O y Ti/TiO₂/Cu₂O por comparación.

Este procedimiento se llevó a cabo empleando un potenciómetro (Figura 54) de resistencia variable de $52k\Omega$ de manufactura casera, conectado a un voltímetro de alta impedancia y a un amperímetro, ambos digitales.



Figura 54. Potenciómetro variable empleado para la obtención de curvas de descarga densidad de corriente vs. potencial.

Los resultados son compilados en la Figura 55. En esta Figura se observa que tanto el potencial a circuito abierto $\Delta\phi_{OCP}$, como la densidad de corriente de cortocircuito j_{sc} de las celdas ensambladas con ánodos Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O y Ti/TiO₂/Cu₂O son mayores que para aquellos dispositivos conteniendo ánodos de TiO₂ desnudo.

CAPITULO 4 Construcción y evaluación preliminar de transducción de energía química en potencia eléctrica empleando electrodos de TiO₂/ Cu₂O



Figura 55. Curvas de descarga obtenidas en régimen estacionario a 298 K para dispositivos voltaicos ensamblados con ánodos de (A) Ti/TiO₂ desnudo, (B) Ti/TiO₂/Cu₂O y (C) Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O.

Considerando que la semireacción catódica involucra al par triioduro/ioduro (Reacción 36 [66]), estos resultados indican por un lado que la reacción de celda global para los tres sistemas puede considerarse termodinámicamente espontánea. Sin embargo, cuando se trata de la semireacción de oxidación, los dos primeros tipos de ánodo (Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O y Ti/TiO₂/Cu₂O) implican la oxidación del Cu₂O (Reacción 37 [67,68]) mientras que en el caso del Ti/TiO₂ desnudo la oxidación de los sitios dopantes Ti³⁺ es viable (Reacción 38 [49]).

$$I_3^- + 2e^- \neq I^ \Delta \phi^{\circ}(I_3^-|I^-) = 0.33 \text{V vs. Fc}^+|\text{Fc}|(36)$$

 $Cu_2O + 2Li^+ \neq 2Cu^{2+} + Li_2O + 2e^ \Delta\phi^{\circ}_{ox}(Cu_2O, Li^+|Cu^{2+}, Li^+)$ (37)

 $[Ti^{3+}(1-\chi)Ti^{4+}]O_{2-\chi}(OH)_{\chi} \rightleftharpoons TiO_{2} + \chi Li^{+} + \chi e^{-} 0 < \chi \le 1 \quad \Delta \phi^{\circ}{}_{ox}(Ti^{3+}, Li^{+}|Ti^{4+}, Li^{+})$ (38)

Específicamente para el caso de los ánodos de tipo Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O y Ti/TiO₂/Cu₂O, el $\Delta\phi_{OCP}$ (=0.525V) es prácticamente el mismo para ambos materiales indicando que la oxidación del Cu₂O es independiente del tipo de comportamiento extrínseco (n ó p) que exhiba este óxido semiconductor. Este importante resultado confirma como verdadera la **Hipótesis 2** de esta tesis.

Complementariamente, los valores de densidad de corriente (j_{sc} , normalizadas al área geométrica) para las celdas que emplean el sistema Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O son 1.5 veces mayores que para aquellas que contienen ánodos de Ti/TiO₂/Cu₂O, mientras que para el sistema Ti/TiO₂ es hasta 37 veces mayor, sugiriendo que la formación de complejos dendrímero-Cu(II) promueve la preconcentración interfacial de estos iones durante la etapa de electrodepósito de Cu₂O [43].

Ahora bien, asumiendo que las semireacciones 36 y 37 se encuentran acopladas para dar lugar a celdas espontáneas de transducción de energía química en electricidad, la reacción global esperada corresponde a:

$$Cu_2O + 2Li^+ + I_3^- \rightarrow 3I^- + 2Cu^{2+} + Li_2O$$
 (39)

Con la finalidad de respaldar la existencia de la Reacción 39, en la siguiente sección se justifica preliminarmente la ocurrencia de la Reacción 37.

2.2.2. Justificación preliminar de reacción global de las pilas ensambladas con ánodos de tipo Ti/TiO₂/Cu₂O y Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O.

El potencial redox estándar para la semireacción de oxidación $\Delta \phi^{\alpha}(Cu_2O,Li^+|Cu^{2+},Li^+)$ pudo ser aproximado para los dos tipos de electrodos estudiados, Ti/TiO₂/Cu₂O y Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O. Para el caso del electrodo Ti/TiO₂/Cu₂O, se encontró que el $\Delta \phi^{\alpha}(Cu_2O,Li^+|Cu^{2+},Li^+)= 0.083V$ vs. Fc⁺|Fc (0.288V vs. ENH) una vez que la Ecuación de Nernst (Ecuación 40) correspondiente a la semireacción de oxidación (Reacción 37) condujo a la correspondiente expresión del potencial redox formal (Ecuación 41). El $\Delta \phi^{\circ}(Cu_2O,Li^+|Cu^{2+},Li^+)$ para las películas de Ti/TiO₂/Cu₂O fue previamente aproximado en 0.100V vs. Fc⁺|Fc a partir de su respuesta voltamperométrica (Figura 56A).

$$\Delta\phi(Cu_2O, Li^+ | Cu^{2+}, Li^+) = \Delta\phi^{\circ\circ}(Cu_2O, Li^+ | Cu^{2+}, Li^+) + \frac{0.06}{2}\log a_{Cu^{2+}}^2$$
(40)

$$\Delta\phi^{\circ'}(Cu_2O, Li^+|Cu^{2+}, Li^+) = \Delta\phi^{\circ}(Cu_2O, Li^+|Cu^{2+}, Li^+) - \frac{0.06}{2}\log[Li^+]^2 \quad \text{donde [Li^+]=0.3M}$$
(41)



Figura 56. Voltamperogramas cíclicos obtenidos para electrodos de (A) Ti/TiO₂/Cu₂O y (B) Ti/TiO₂/M-Dends/Cu₂O sumergidas en una celda de 3 electrodos conteniendo carbonato de propileno + LiN(F_3SO_2)₂ 0.3M a 25°C (dE/dt=25mV/s). Alambres de Ag y Pt fueron insertados como pseudo-referencia y contraelectrodo, respectivamente. Los potenciales fueron referenciados al potencial del par Fc⁺|Fc.

Siguiendo el mismo razonamiento, para el caso del electrodo Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O en contraste, se encontró que el $\Delta\phi^{\alpha}$ (Cu₂O,Li⁺|Cu²⁺,Li⁺)= 0.059V vs. Fc⁺|Fc (0.264V vs. ENH) luego de que el $\Delta\phi^{\alpha}$ (Cu₂O,Li⁺|Cu²⁺,Li⁺) para estas películas fue estimado en 0.075V vs. Fc⁺|Fc a partir de su respuesta voltamperométrica (Figura 56B).

Una inspección de los valores de $\Delta \phi$ (Cu₂O,Li⁺|Cu²⁺,Li⁺) estimados para los sistemas Ti/TiO₂/Cu₂O y Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O (0.288V y 0.264V vs. ENH, respectivamente) sugiere que son muy cercanos al de la Reacción 42, típicamente observada en medio acuoso ácido, justificando de este modo la forma de la reacción de descarga propuesta con anterioridad para las pilas bajo estudio (Reacción 39).

$$Cu_2O + 2H^+$$
 ≈ $2Cu^{2+} + H_2O + 2e^- \Delta\phi^{\circ}(Cu_2O, H^+|Cu^{2+}, H^+) = 0.203V$ vs. ENH (42)

La diferencia de algunos mV entre los valores de $\Delta \phi (Cu_2O,Li^+|Cu^{2+},Li^+)$ estimados para los sistemas que involucran a Ti/TiO₂/Cu₂O y Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O (85 y 61mV, respectivamente) y el $\Delta \phi (Cu_2O,H^+|Cu^{2+},H^+)$, puede ser atribuido a que se despreció el efecto de los coeficientes de actividad iónico medio. No obstante, asumiendo que el límite típico de error en las técnicas voltamperométricas es de ±10mV, podemos considerar que los datos teóricos obtenidos pueden ser aceptables sólo para efectos de comparación de tendencias.

Por otro lado, los resultados de esta sección también logran dar soporte al razonamiento previamente propuesto en la sección 3 del capítulo 2 (Figura 15), donde se esperaba que el potencial redox estándar del electrodo de Ti/TiO₂/Cu₂O (tipo n) debería ser más positivo que el del electrodo Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O (tipo p). Sin embargo, la diferencia entre ambos potenciales es de sólo unos 24mV, sugiriendo que el potencial a circuito abierto ($\Delta\phi_{OCP}$ = 0.525V) de las celdas ensambladas con ambos tipos de ánodos es mayor a los predichos por la Ecuación 43 (0.247V y 0.271V para Ti/TiO₂/Cu₂O y Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O, respectivamente).

$$\Delta \phi^{\circ}_{\text{OCP}} = \Delta \phi^{\circ}(I_{3}|I) - \Delta \phi^{\circ}(\text{Cu}_{2}\text{O},\text{Li}^{+}|\text{Cu}^{2+},\text{Li}^{+})$$
(43)

2.2.3. Justificación de los potenciales a circuito abierto en dispositivos voltaicos ensamblados con ánodos de Ti/TiO₂/Cu₂O y Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O.

La Ecuación de Nernst correspondiente a la Reacción 39 (Ecuación 44) indica que el potencial de circuito abierto de las celdas depende fuertemente de la actividad de los iones Cu^{2+} (a_{Cu2+}), más que de la actividad los otros iones que *a priori* se sabe que se encuentran en disolución antes de la descarga de las celdas (ver Ecuación 45).

$$\Delta\phi_{OCP} = \Delta\phi_{OCP}^{\circ} + \frac{0.06}{2}\log\frac{a_{Cu_2O}a_{Li^+}^2a_{I_3^-}}{a_{I_1^-}^3a_{Cu^{2+}}^2a_{Li_2O}}$$
(44)

$$\Delta\phi_{OCP} = \Delta\phi_{OCP}^{\circ} + \frac{0.06}{2}\log\frac{a_{Li^{+}}^{2}a_{I_{3}^{-}}}{a_{I^{-}}^{3}} - 0.06\log a_{Cu^{2+}} \quad \text{donde } a_{Cu2O} = a_{Li2O} \approx 1$$
(45)

Entonces, una vez que la Relación 45 es alimentada por un lado, con las concentraciones de los iones Li⁺ (0.3M), I₃⁻ (0.015M), I⁻ (0.285M) como burda aproximación a sus actividades, y por otro lado con el $\Delta \phi^{\circ}_{OCP}$ esperado para cada sistema (0.247V 0.271V para Ti/TiO₂/Cu₂O Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O, V V respectivamente), los valores de a_{Cu2+} pudieron ser estimados revelando que tienen magnitudes muy pequeñas (5.6×10⁻⁶ y 1.4×10⁻⁵ para Ti/TiO₂/Cu₂O y Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O, respectivamente). Estos resultados revelan que una vez que las celdas se descargan y los iones Cu²⁺ son liberados al electrolito, sus potenciales electroquímicos $\tilde{\mu}_{c,2+}$ son casi nulos, sugiriendo de este modo que una reacción química consecutiva pudiera estar acoplada a la reacción global de descarga.

Una búsqueda en la literatura de las semirreacciones que involucran a las especies electroactivas contenidas en las celdas estudiadas, dio lugar a la construcción de la Figura 57 [69]. En este Figura puede destacarse que la reacción en fase homogénea que consume iones Cu²⁺ liberados al medio durante la descarga de los dispositivos, podría ser de origen redox e involucraría la formación espontánea de Cul vía la

Reacción 46 catalizada por el Cu° previamente generado como producto secundario del paso de electrodepósito de Cu₂O (Reacción 16).

 $Cu^{2+} + 2Cu^{\circ} + 2I^{-} \rightarrow Cu^{\circ} + 2Cul$ (46)



Figura 57. Diagrama de potenciales termodinámicos estándar para las semireacciones que involucran a las especies electroactivas contenidas en las celdas estudiadas. La regla nemotécnica de la "S" indica que la Reacción XII es termodinámicamente espontánea [69].

En virtud de que los dispositivos voltaicos ensamblados con ánodos de Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O exhiben curvas de descarga con una densidad de corriente a corto-circuito (j_{sc}) mayor que las de aquellas celdas que emplean ánodos de Ti/TiO₂/Cu₂O, en la siguiente sección se detallarán los experimentos enfocados a mejorar la magnitud de la j_{sc} de electrodos de Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O empleados en el diseño de celdas voltaicas.

2.3. Modificación química de los electrodos de Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O empleados para ensamblar dispositivos voltaicos.

Bisquert y col. [70], así como, Godínez y col. [49] han demostrado que los depósitos electroforéticos de TiO₂ nanoparticulado son capaces de formar superficies altamente porosas de este material semiconductor. Sin embargo, se determinó que sólo un 10% de la superficie del sustrato original tiene contacto eléctrico con las nanopartículas de TiO₂. Este peculiar evento promueve que la carga electrónica que se transporta a través de la película sea parcialmente secuestrada por el ión l⁻ contenido en el medio electrolítico en dos puntos críticos (Figura 58): Zona I, aquella fracción del sustrato que no tiene contacto alguno con las partícula de TiO₂, solo con el electrolito; y Zona II, aquella fracción de TiO₂ que no fue cubierta por el electrodepósito de Cu₂O.



Figura 58. Representación esquemática de una superficie de Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O en contacto galvánico con el par triioduro|ioduro.

Los ácidos organotiolados como el ácido mercaptopropiónico (MPA, por sus siglas en inglés mercaptopropionic acid) poseen dos cabezas con reactividad química distinta (HSCH₂CH₂COOH) que la convierte en una molécula única. Por un lado, los estudios enfocados a la formación de monocapas autoensambladas de organotioles sobre electrodos metálicos (como el Au, Ag y Cu) han demostrado la reactividad selectiva del grupo mercaptano (SH) por las superficies de esta índole (Reacción 47) [71]. Por otro lado, los estudios enfocados a la adsorción de sensibilizadores de TiO₂ con terminación carboxilada en celdas solares Grätzel demuestran la adsorción selectiva del grupo carboxilo (COOH) por las superficies de TiO₂ según la Reacción 48 [72].



De acuerdo con los antecedentes arriba comentados, en este trabajo de investigación se procedió a modificar químicamente la superficie de electrodos de Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O con MPA, esperando que las moléculas de MPA sean confinadas sólo en las Zonas I y II, gracias a sus grupos SH y COOH, respectivamente. Como consecuencia de estos eventos, se busca finalmente que el Cu₂O superficial siga siendo electroactivo, como para que la corriente colectada en el circuito externo durante la descarga de dispositivos voltaicos ensamblados con ánodos de Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O/MPA sea mayor que la de celdas que emplean electrodos de Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O libre de MPA.

2.3.1. Metodología experimental

Electrodos de Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O recién preparados fueron sumergidos por 12h en una disolución de EtOH + 1mM de MPA (HSCH₂CH₂COOH, Aldrich 99.9%). Una vez que el tiempo de inmersión terminó, los electrodos así modificados son enjuagados con EtOH y carbonato de propileno limpios antes de ser usados.

2.3.2 Descarga en régimen estacionario de los dispositivos voltaicos ensamblados con ánodos de Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O modificados con MPA.

Este procedimiento se llevó a cabo empleando nuevamente la metodología descrita en la sección 2.2.1. La Figura 59 muestra las curvas de descarga para celdas voltaicas ensambladas con ánodos de Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O y Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O/MPA. Los resultados indican que las celdas que contienen electrodos de Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O/MPA muestran una densidad de corriente a corto-circuito 2 veces mayor que para aquellos dispositivos que emplean Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O como ánodo. Por otro lado, el potencial a circuito abierto de los dispositivos se mantiene constante implicando que la superficie de Cu₂O previamente electrodepositada no ha sido modificada en términos químicos por la presencia del MPA.

De esta forma, los afectos combinados de aumento de j_{sc} y de $\Delta \phi_{OCP}$ constante para las celdas voltaicas ensambladas con electrodos de tipo TiO₂/M-Dens/Cu₂O/MPA, sugieren fuertemente que la modificación de estas superficies por parte de las unidades de MPA se efectuó en las Zonas I y/o II de las mismas (ver Figura 58). En este contexto, un nuevo proyecto de investigación estará enfocado a averiguar si ambas zonas o sólo una de ellas es selectivamente cubierta por el MPA. Por lo pronto, la información energética de los dispositivos evaluados es discutida a continuación.

CAPITULO 4 Construcción y evaluación preliminar de transducción de energía química en potencia eléctrica empleando electrodos de TiO₂/ Cu₂O



Figura 59. Curvas de descarga en régimen estacionario obtenidas a 298K para dispositivos voltaicos ensamblados con base en ánodos de (A) TiO₂/M-Dens/Cu₂O y (B) TiO₂/M-Dens/Cu₂O/MPA.

2.4. Propiedades energéticas de los dispositivos voltaicos ensamblados con ánodos de Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O y Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O/MPA.

2.4.1. Metodología experimental

Las propiedades energéticas de los dispositivos voltaicos fueron calculadas a partir de su proceso de descarga en dos modalidades: (A) en **régimen estacionario** (independiente del tiempo) siguiendo metodología establecida en la sección 2.3.2. de este capítulo, y (B) como **transitorios de potencial de celda** (como función del tiempo) empleando el potenciómetro variable mostrado en la Figura 54. Para el caso (B), valores de resistencia patrón apropiados fueron seleccionados de modo que permitieran situar la descarga de cada tipo de celda, justo en la posición de máxima potencia observada en las curvas bajo régimen estacionario de la Figura 59. Una vez que se seleccionaron las resistencias apropiadas en modo de circuito-abierto, el sistema completo viró a posición de corto circuito para que las celdas bajo estudio se descargaran progresivamente. La descarga completa de las celdas se estableció registrando el tiempo en el cual el potencial de celda alcanzó un valor de cero.

Por otro lado, la masa electroactiva de Cu₂O ($m_{Cu₂O}$) por unidad de área geométrica en las superficies de Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O y Ti/TiO₂/Cu₂O fue determinada alimentando la carga faradaica Q_{Cu20} asociada al depósito según la Reacción 16 de de Cu₂O en la Ecuación de Faraday (Ecuación 49, donde A_q y M_{Cu2O} son área geométrica del electrodo y la masa molecular del Cu₂O, respectivamente). Los resultados indicaron 1983.84µgCu₂O/cm² de Cu₂O electrodepositada fue que la masa V 3064.04µqCu₂O/cm² para los ánodos de Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O y Ti/TiO₂/Cu₂O, respectivamente.

$$m_{Cu_2O} = \frac{Q_{Cu_2O}}{nFA_g} M_{Cu_2O}$$
(49)

Estas cantidades confirman como verdadera la **Hipótesis 1** planteada en la introducción de este trabajo, donde se infería que la presencia de dendrímeros sobre las superficies de TiO₂ podría preconcentrar a los iones Cu^{2+} justo antes de iniciar el proceso de electrodepósito.

2.4.2. Cálculo de los parámetros energéticos de los dispositivos voltaicos

La **potencia específica** (W/kg) de las celdas ensambladas con ánodos Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O y Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O/MPA se determinó y compiló en la Tabla 1 a partir de sus respectivas curvas de descarga en régimen estacionario de acuerdo con la Relación 50, donde P_{max} es la potencia máxima de descarga en régimen estacionario.
$$W_{esp,Cu_2O} = \frac{P_{\max,Cu_2O}}{m_{Cu_2O}}$$
(50)

Una inspección de la Tabla 1, indica que la potencia específica para celdas conteniendo el sistema Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O/MPA es casi 2 veces mayor que para las celdas ensambladas con Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O, justificando la relación entre las áreas bajo las curvas de descarga presentadas en la Figura 60. Finalmente, es interesante destacar que ambos tipos de celdas exhibieron potencias específicas mayores que aquellas ensambladas con electrodos de tipo Ti/TiO₂/Cu₂O (ausencia de dendrímeros superficiales sobre TiO₂ durante la etapa de electrodepósito de Cu₂O).

Posteriormente, la **energía específica** (Wh/kg) se obtuvo y compiló en la Tabla 1 mediante el producto de la potencia específica y el tiempo de descarga (τ_{Cu2O}) de cada sistema (Ecuación 51). En este contexto, los tiempos de descarga obtenidos experimentalemente fueron de 0.9h y 1.5h para los sistemas Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O y Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O/MPA, respectivamente, revelando que el segundo tipo de celda proporciona potencia eléctrica máxima por un periodo de descarga casi 3 veces mayor que las primeras.

$$E_{esp,Cu_2O} = W_{esp,Cu_2O} \times \tau_{Cu_2O}$$
(51)

Finalmente, mediante la Relación 52 donde j_{max} es la densidad de corriente asociada a la P_{max} , la **capacidad específica** (mAh/g) pudo ser estimada para celdas ensambladas con Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O y Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O/MPA. Dado que Q_{esp} y E_{esp} son dos parámetros dependientes uno del otro, se encontró efectivamente que Q_{esp} para celdas con ánodos de Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O/MPA proporcionan corriente eléctrica por un periodo de descarga 3 veces mayor que las celdas conteniendo ánodos de Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O.

$$Q_{esp,Cu_2O} = \frac{j_{\max}}{m_{Cu_2O}} \times \tau_{Cu_2O}$$
(52)

Los resultados de esta sección también indican que la capacidad específica de los dispositivos voltaicos construidos con ánodos de Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O/MPA es comparable con la de materiales relacionados como TiO₂ (305mAh/g) [73], CuO (500mAh/g), SnO₂ (400mAh/g) y MoO₃ (150mAh/g), que son típicamente empleados en el diseño de capacitores electrolíticos [64]. En este sentido, los materiales aquí diseñados son preferenciales en la construcción de pilas o baterías, ya que los valores de potencia específica no son tan altos como los alcanzados por los capacitores electrolíticos, pero proporcionan energía por largos periodos de descarga (parámetro que se busca sea muy corto en el caso de los capacitores electrolíticos).

Tabla 1. Parámetros energéticos de los dispositivos de transducción de energía química en potencia eléctrica. N.D. indica "no determinado".

Tipo de ánodo	W _{esp,Cu2O} (W/kg)	E _{esp,Cu20} (Wh/kg)	Q _{esp,Cu2O} (mAh/g)
Ti/TiO ₂ /Cu ₂ O	12.0	N.D.	N.D.
Ti/TiO ₂ /M-Dens/Cu ₂ O	13.8	12.4	37.7
Ti/TiO ₂ /M-Dens/Cu ₂ O/MPA	27.0	40.5	122.4

La posición energética de las pilas diseñadas y ensambladas en este trabajo, se representa comparativamente en el entorno de otros dispositivos electroquímicos de almacenamiento y conversión de energía química en potencia eléctrica con ayuda del Diagrama de Ragone de la Figura 60 [48].

CAPITULO 4 Construcción y evaluación preliminar de transducción de energía química en potencia eléctrica empleando electrodos de TiO₂/ Cu₂O



Figura 60. Diagrama de Ragone que muestra la posición energética de las pilas ensambladas con ánodos de Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O y Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O/MPA, en el contexto de varios dispositivos electroquímicos de almacenamiento y conversión de energía química en electricidad.

2.5. Conclusiones

Se demostró que las nanoestructuras de Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O y Ti/TiO₂/M-Dens/Cu₂O/MPA son capaces de actuar como ánodos en pilas o baterías proporcionando potenciales a circuito abierto de ~0.5V y capacidades específicas de ~38 de 122 mAh/g, respectivamente. La potencia específica de ambas superficies resultó ser mejor que la celdas ensambladas con ánodos de Ti/TiO₂/Cu₂O, destacando la importancia del uso de películas de TiO₂ funcionalizadas con dendrímeros durante la etapa de electrodepósito de Cu₂O. Conclusiones generales y perspectivas a futuro

"Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una víctoría completa"

Mahatma Gandhi

1. Conclusiones generales

En este trabajo de investigación, la caracterización, manipulación y ensamblado de materiales semiconductores nanoestructurados de TiO₂/Cu₂O dio lugar al desarrollo de un dispositivo de conversión de energía química en potencia eléctrica.

En el Capítulo 1 se dieron a conocer los aspectos teóricos de los electrodos semiconductores másicos y nanoestructurados, así como también se discutió sobre el papel fundamental que los segundos tienen en la construcción de dispositivos de transducción de energía electroquímica.

Las diferentes técnicas de obtención del Cu₂O fueron discutidas en el Capítulo 2, siendo la técnica de electrodepósito la más viable en virtud de que requiere una infraestructura sencilla. Por otro lado, en este capítulo la investigación se enfocó a la optimización de la técnica de depósito de nanoestructuras conformadas por la heterounión TiO₂/Cu₂O. Se encontró que la obtención de Cu₂O tipo n y p puede ser seleccionada por el experimentador cuando la superficie de los electrodos se encuentra libre o modificada químicamente con películas de dendrímeros de polamidoamina (PAMAM), respectivamente. En el caso de los depósitos de Cu₂O tipo n, estos fueron obtenidos con un contenido menor de Cu metálico que para los depósitos de Cu₂O tipo n.

En el capítulo 3, las técnicas de depósito de las películas de TiO₂/Cu₂O previamente optimizadas y descritas en el Capítulo 2, fueron extrapoladas a un sustrato de Ti metálico. En primer lugar, películas de TiO₂ con una gran área electroactiva fueron obtenidas empleando un protocolo electroforético. Posteriormente, películas de Cu₂O se obtuvieron sobre TiO₂ mediante la técnica de electrodepósito aplicando un potencial de -50 mV durante 90 minutos. Se observó que cuando el TiO₂ era previamente modificado con dendrímeros PAMAM generación 3.5 (64 grupos COOH periféricos), un efecto de control interfacial del *pH* permitió un electrodepositar Cu₂O tipo p con un bajo contenido de Cu metálico. En caso contrario, cuando se empleaba TiO₂ desnudo, se lograban depósitos de Cu₂O tipo n con alto contendido de Cu metálico. La caracterización de las películas fue llevada a cabo mediante espectroscopia UV-Vis,

99

difracción de rayos X, microscopia de barrido electrónico, voltamperometría cíclica y espectroscopia de fotocorriente.

En el capítulo 4, el uso de las películas nanoestructuradas de TiO₂/Cu₂O fue explorada como ánodos para la construcción de dispositivos de transducción de energía química en potencia eléctrica, cuando las celdas ensambladas para este efecto contenían el par redox triioduro-ioduro como semireacción catódica. El potencial a circuito abierto de los dispositivos así construidos fue 0.5V generalmente. Posteriormente, se demostró que la modificación de los ánodos de TiO₂O/Cu₂O con ácido mercaptopropiónico permitió incrementar la potencia de descarga de las celdas experimentales, gracias a que permite bloquear las zonas nanométricas de fuga de los electrones que viajan hacia el circuito exterior y a través del soporte de TiO₂, desde los sitios donde el Cu₂O sufre un proceso de oxidación espontánea por parte del par triioduro-ioduro.

2. Perspectivas a futuro

A partir de los estudios y discusiones presentados en esta tesis, las perspectivas de trabajos futuros se presentan a continuación.

En primera instancia, sería interesante complementar los estudios de XRD de las nanoestructuras de TiO₂/Cu₂O mediante el método de Rietveld [74], con la finalidad de obtener con mayor precisión la cantidad de Cu₂O presente en las mismas con relación al Cu metálico.

Por otro lado, es importante continuar con el entendimiento de las propiedades electroquímicas de las películas nanoestructuradas de TiO_2/Cu_2O que fueron empleadas como ánodos en pilas. En este sentido, es importante realizar experimentos que permitan validar de una manera más certera, la reacción de oxidación que ocurre en el proceso de descarga de las pilas estudiadas. Esto podría ser explorado mediante técnicas que permitan evaluar el estado de oxidación de los átomos de cobre presentes en los ánodos de las pilas una vez que fueran descargadas, por ejemplo, la espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS, por sus siglas en inglés *X-ray photoelectron spectroscopy*).

100

Anexos

Técnicas experimentales empleadas

1. Técnicas empleadas

En este apartado se describen brevemente los principios básicos de las técnicas de caracterización química, estructural y eléctrica utilizadas en este trabajo.

1.1. Voltamperometría cíclica (VC)

Esta técnica se basa en la aplicación de un barrido triangular de potencial al electrodo (Figura 61). Este barrido de potencial comienza en un valor inicial E_i hasta un valor de inversión E_{inv} [3].



Figura 61. Perfil de la perturbación en la voltamperometría cíclica.

Cabe mencionar que el potencial final del barrido no necesariamente debe coincidir con el potencial inicial, pero si es elemental considerar los valores de potencial a circuito abierto E_{OC}, potencial de inversión anódica E_{ia} y potencial de inversión catódica E_{ic}. Asimismo, el barrido de voltaje puede ser iniciado en cualquier sentido (anódico, catódico) y repetirse las veces necesarias. Una representación de un sistema reversible se puede ver en la Figura 62, considerando que el barrido se inicia en sentido anódico ($Red \rightarrow 0x$) partiendo del E_{OC}, se observa que al alcanzar valores de potencial a los cuales se produce un proceso de transferencia de carga entre el conductor eléctrico y el iónico, es decir una reacción redox, el valor de la corriente comienza a incrementar hasta un valor máximo (i_{pa}) que está relacionado con los procesos de difusión del sistema. Al barrer en sentido inverso, se aprecia la onda correspondiente al proceso electroquímico inverso ($0x \rightarrow Red$). El ciclo en este caso finaliza en el E_{OC}.



Figura 62. Representación gráfica de una voltamperometría cíclica reversible en sentido de oxidación. Red representa la especie reducida y Ox la oxidada, i_{pa} e i_{pc} son la corriente de pico anódico y catódico respectivamente.

El tratamiento matemático que proporciona expresiones teóricas que a su vez permitan relacionar la corriente y el potencial de pico, sin despreciar a otros parámetros experimentales como concentración, velocidad de barrido, temperatura, es similar tanto para procesos reversibles como irreversibles. La diferencia radica en las distintas características cinéticas de los procesos y por tanto, en las condiciones necesarias para resolver el correspondiente sistema de ecuaciones diferenciales.

Para un proceso reversible se cumple con la ecuación de Randles-Sevcik [75], donde la velocidad de transferencia electrónica debe ser muy rápida

$$I_n = 2.69 \times 10^5 n^{3/2} A D^{1/2} v^{1/2} C \tag{53}$$

donde I_p es la corriente de pico, n el número de electrones transferidos, A el área, D el coeficiente de difusión de la especie oxidada, v la velocidad de barrido y C la concentración en el seno de la disolución de la especie oxidada.

Otro criterio de reversibilidad radica en que la separación de los potenciales de pico anódico E_{pa} y potencial de pico catódico E_{pc} debe cumplir con la siguiente relación:

$$\Delta E = |E_{pa} - E_{pc}| = 2.303 \frac{RT}{nF}$$
(54)

En otras palabras, la separación de picos para un sistema reversible debe ser aproximadamente 60 mV por electrón intercambiado. Entre mayor sea ésta separación, el sistema se vuelve más lento convirtiéndose en un proceso irreversible.

En el caso de los sistemas irreversibles el proceso está controlado por transferencia electrónica y por difusión. A bajas velocidades de barrido la transferencia de electrones predomina sobre la transferencia de masa y el sistema se comporta como un proceso reversible. Sin embargo, mientras la velocidad de barrido aumenta, la velocidad de transporte de masa incrementa, comportándose como un sistema irreversible y el efecto en la forma de los voltamperogramas es la separación de los picos anódico y catódico. Este tipo de sistemas cumple con la siguiente ecuación.

$$I_p = 2.69 \times 10^5 n (\alpha n_a)^{1/2} A D^{1/2} v^{1/2} C$$
(55)

siendo α el coeficiente de difusión y n_a es el número de electrones transferidos en el paso determinante de la reacción. En ambos procesos (reversible e irreversible) la corriente de pico es proporcional a la raíz cuadrada de la velocidad de barrido, siempre

que la disolución se mantenga estática y con exceso de electrolito soporte para evitar efectos de convección y migración, respectivamente.

1.2. Difracción de rayos X (XRD)

Los rayos X fueron descubiertos en 1895 por el físico alemán Roentgen y fueron llamados así por su naturaleza desconocida en ese tiempo. Se sabe hoy en día, que los rayos X son una radiación electromagnética de exactamente la misma naturaleza que la luz visible pero de una longitud de onda mucho más corta.

Mediante la difracción de rayos x se puede obtener información sobre la estructura cristalina de un material. El arreglo periódico de los átomos en las estructuras cristalinas puede funcionar como una rejilla de difracción para ondas con longitudes de onda del orden de la separación de los átomos (del orden de angstroms). Esta longitud de onda es la correspondiente a los rayos X (0.5 a 2.5 Å) y la energía correspondiente es de 6-17 keV.

Un modelo sencillo para explicar esta técnica fue propuesto por W. L. Bragg [76]. Este modelo consiste en suponer que las ondas monocromáticas incidentes son reflejadas especularmente por los planos paralelos sucesivos de los átomos del cristal, donde cada plano refleja sólo una pequeña fracción de la radiación incidente. Los haces difractados podrán verse sólo cuando las reflexiones en planos paralelos interfieran constructivamente (Figura 63). La ley de Bragg se describe mediante la siguiente ecuación.

$$n\lambda = 2dsen\theta \tag{56}$$

donde n es un número entero que hace referencia al orden de difracción, λ es la longitud de onda del haz incidente, d es la distancia entre los planos atómicos y θ es el ángulo de incidencia de la radiación. Es necesario mencionar que la ecuación 56 no toma en cuenta la variación en la dirección de propagación de la onda, cuando ésta

pasa de un medio a otro, lo cual provocaría que el espacio que realmente recorre sea un poco diferente de $2dsen\theta$.



Figura 63. Esquema de difracción de rayos X producida por un cristal, donde d es el espaciado interplanar de los planos cristalinos hkl y Θ es el ángulo de difracción.

Por otro lado, los espectros de difracción de un material cristalino también nos permiten determinar el tamaño del cristal del material D en Å a partir de la ecuación de Scherrer [77]

$$D = \frac{k\lambda}{\beta\cos\theta} \tag{57}$$

donde *k* es una constante (relativa a la forma de los cristales) y β es la anchura de la semialtura de cada pico de difracción medida en radianes.

Dentro de las aplicaciones de la técnica de XRD se pueden destacar las siguientes

- Identificación de fases cristalinas y su composición química
- Determinación de orientación preferente
- Determinación de tensiones y tamaño de cristal
- Determinación del espesor de la película

1.3. Microscopia electrónica de barrido SEM

El microscopio electrónico de barrido (SEM) es un instrumento que permite la visualización y caracterización superficial de materiales inorgánicos y orgánicos. Es una técnica no destructiva, ya que genera información sobre la morfología y composición del material analizado.

Esta técnica consiste en hacer incidir un haz de electrones sobre la muestra y mediante un detector apropiado, registrar el resultado de esta interacción [78]. Cuando un haz de electrones incide sobre la superficie de un sólido, varios fenómenos como la reemisión de una parte de la radiación incidente, emisión de luz, emisión de electrones secundarios y rayos X tienen lugar (Figura 64).

Por otro lado, las imágenes que se obtienen en el microscopio electrónico de barrido corresponden a electrones secundarios o electrones retrodispersados tras la interacción con la muestra de un haz incidente de entre 5 y 30 KeV. En este contexto, un mayor poder de penetración se obtiene cuando se aplica un mayor voltaje al haz, obteniéndose de esta manera la información de un área mayor de la muestra. En cuanto a la resolución, esta depende de distintos factores como el tamaño de haz de electrones, la cantidad de electrones secundarios o retrodispersados y de la relación señal/ruido.

En cuanto a la señal de electrones retrodispersados, su principal utilidad reside en que su emisión depende fuertemente del número atómico de los elementos contenidos en la muestra. Esto implica que dos partes de la muestra que tengan distinta composición se muestran con distinta intensidad aunque no exista diferencia topográfica entre ellas. Las zonas con elementos de menor número atómico se verán más oscuras que las zonas que tienen elementos con mayor número atómico.



Figura 64. Señales emitidas por un material bombardeado con un haz de electrones $e.e_1$ son los electrones del haz primario o reflejados en la muestra, e_2 son los electrones arrancados a los átomos de la muestra por la acción de bombardeo del haz primario

1.3.1 Espectroscopia de energía dispersiva de rayos X (EDS)

Cuando sobre una muestra inciden electrones de energía apropiada se producen rayos X, cuya energía y abundancia relativa dependen de su composición. Este fenómeno se usa para analizar el contenido elemental de una muestra sólida (en un rango de una a cientos de micras cúbicas) y se le conoce como microanálisis [79].

El dispositivo de microanálisis está acoplado al microscopio electrónico y permite la identificación tanto cualitativa como cuantitativa de los elementos químicos de la muestra. El principio que describe la técnica es el siguiente: cuando un electrón es arrancado de una capa electrónica interna, por efecto de la interacción de un haz de electrones de alta energía, el resultado es un ión en un estado excitado. A causa de los procesos de relajación, el ión excitado cede energía para volver a su estado normal o fundamental. El proceso más probable, en la mayoría de los casos, es una serie de transformaciones que tienen como resultado que un electrón de otra capa superior caiga a la vacante de la capa interna. Cada caída está asociada a la pérdida de una determinada cantidad de energía que es la diferencia de energía entre los dos niveles electrónicos implicados en el proceso. Esta energía se pone de manifiesto en forma de

Rayos X. La energía de la radiación es la emisión característica del elemento químico del que proviene.

Un espectro de EDS exhibe normalmente los picos que corresponden a los niveles de energía para los cuales la mayoría de los rayos X han sido recibidos. Cada uno de estos picos es único a un átomo, y por lo tanto corresponde a un solo elemento, es decir, el pico de un espectro corresponde a un elemento presente en el sólido. Las posiciones de las líneas (picos con energías apropiadas) dan información sobre la composición cualitativa de la muestra.

1.4. Perfilometría

Es una técnica que permite medir espesores de películas, los cambios más comunes son de 200 Å a 65 μ m, así como la rugosidad, que es una medición a pequeña escala de la variaciones en la altura de una superficie física, la resolución horizontal depende del radio de la punta.

La punta recorre la superficie de la muestra aplicando sobre ella una fuerza constante (la longitud de barrido y la magnitud de la fuerza dependen de las características de la muestra). La punta está conectada a un sistema de medición que grafica los desplazamientos verticales que sufre en su recorrido a lo largo de la superpicie de la muestra. (Figura 65)



Figura 65. Esquema del perfilometro

- 1. R.J. Candal, S.A. Bilmes y M.A. Blesa, Semiconductores con Actividad Fotocatalítica, 2da Ed, CYTED, Madrid, 2004, 79
- J. Koryta, J. Duorak, L Kavan Wiley, Principles of Electrochemistry, 2nd Ed, John Wiley & Sons, New York, 1993, 87
- 3. J. Bard y L. Faulkner, Electroquemical methods, 2nd Ed, John Wiley & Sons, New York, 2001, p. 398, 746
- D. Jiang, Tesis Doctoral, Studies of Photocatalytic Processes at Nanoporous TiO₂ Film Electrodes by Photoelectrochemical Techniques and Development of a Novel Methodology for rapid determination of chemical oxigen demand, Griffith University. Griffith (2004)
- 5. Handbook of electrochemistry, 1st ed, ELSEVIER, New Mexico, 2007, 329
- 6. J. O'M. Bockris y A.K.N. Reddy, *Electroquímica Moderna*, Vol. 2, Reverte, España, 1980, 850-856
- 7. Y. Xu y M. Schoonen, American Mineralogist 85 (2000) 543
- 8. M. Grätzel, *Heterogeneous Photochemical Electron Transfer*, CRC Press, Inc. Florida, 1987, 107
- 9. L. Kavan y M. Grätzel, *Electrochemica Acta* 40 (1995) 643
- 10. N. Alonso-Vante, *Electroquímica y Electrocatálisis Vol. 1b*, Libro.Net, Buenos Aires, 2003, 20-24
- 11. W.J. Albery y P.N Bartlett, J Electrochem. Soc. 131 (1984) 315
- 12. M. Lira, Avance y perspectiva **10** (2001) 39
- Y.G. Zhang, L.L. Ma y Y. Yu, Environmental Science and Technology 41 (2007) 6264
- W. Siripala, A. Ivanovskaya, T. F. Jaramillo, S. Baeck y E. W. McFarland, Solar Energy and Solar Cells 77 (2003) 229
- K. Akimoto, S. Ishizuka, M. Yanagita, Y. Nawa, G. Paul y T. Sakurai, Solar Energy 80 (2006) 715
- 16. Y. Tang, Z. Chen, Z. Jia, L. Zhang y Li. Lialin, Materials Letters 59 (2005) 434
- J.Y. Xiang, J.P. Tu, Y.Z. Huang y Y.Z Yang, J Solid State Electrochem 12 (2008)
 941
- P.E. Jongh, D. Vanmaekelbergh y J.J Kelly, *Journal of The Electrochemical* Society, **147** (2000) 486

- 19. R. Garuthara y W. Siripala, Journal of Luminescence 121 (2006) 173
- 20. C.J. Engel, T.A. Polson, J.R. Spado, J.M. Bell y Fillinger, A. Journal of The Electrochemical Society, **155** (2008) F37-F42
- 21. M. Okuya, K. Nakade, D. Osa, T. Nakano, G. Kumara y S. Kaneko, *Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry* **164** (2004) 167
- 22. M. Valtierra, J. Ortiz, P. Bosch, J. de los Reyes y V. Lara, *Revista Mexicana de Ingeniería Química* **2** (2003) 69
- A. Herrera, Tesis de Maestría, Crecimiento y Caracterización de Películas Delgadas Ferroeléctricas de Ba_{1-x}Sr_xTiO₃ por la Técnica de Sputtering, IPN, Altamira, (2005)
- 24. J. Pardilla, Tesis Doctoral, "Síntesis y caracterización de polímeros conductores basados en anilinas sustituidas y su aplicación en electrocatálisis", Universidad de Alicante, Alicante (2007)
- 25. Y. Xhou, y J. Switzer, *Mat Res Innovat* **2** (1998) 22
- 26. E. Ko, J. Choi, K. Okamoto, Y. Tak y J. Lee, Chem Phys chem 7 (2006) 1505
- 27. A-L. Daltin, A. Addad y J-P. Chopart, Journal of Crystal Growth 282 (2005) 414
- T. Mahalingam, J. Chitra, C. Velumani y P. Sebastian, Solar Energy Materials & Solar Cells 88 (2005) 209
- K. Jayathileke, W. Siripala y J. Jayanetti, *Proceedings of the Technical Sessions*,
 23 (2007) 55
- 30. W. Shang, X. Shi, X. Zhang, C. Ma y C. Wang, Applied Physics A 87 (2007) 129
- C. A. N. Fernando, P.H.C. de Silva, S. K. Wethasinha, I.M. Dharmadasa, T. Delsol y M.C. Simmonds, *Renewable Energy* 26 (2002) 521
- 32. J. Büdiené, P. Kalinauskas y A. Survila, Chemija 17 (2006) 7
- 33. W. Siripala y J. Jayakody, Solar Energy Materials, 14 (1986) 23
- 34. P. Jongh, D. Vanmaekelbergh y J. Kelly, Chem. Mater 11 (1999) 3512
- 35. H. Solache-Carranco, J. Juárez-Díaz, J. Martínez-Juárez y R. Peña-Sierra *Revista Mexicana de Física* **55** (2009) 393
- 36. J. Bloem, V. Houven van Oordt y F. Kröger, Physica 22 (1956) 1254
- 37. W. Siripala et al. Solar Energy Materials & Solar Cells 77 (2003) 229
- 38. J.M. Costa, "Fundamentos de Electródica. Cinética Electroquímica y sus Aplicaciones", Alhambra Universidad, Madrid, 1981, 14
- 39. M. Martinelli, P. Froimowicz, M. Calderón y M. Strumia, *Revista Iberoamericana de Polímeros* **4** (2003)

- 40. B. Klajnert y M. Bryszewska, Acta Biochimica Polonica 48 (2001) 199
- 41. Z. Quiang, Z. Wang, Q. Rong, Z. Guo, H. Chang, Y. Fu y Y. Pu, *Chinese Chemical Letters* **13** (2002) 491
- 42. E. Bustos, J. Manríquez, G. Orozco y L.A. Godínez, Langmuir 21 (2005) 3013
- 43. M. Ottaviani, S. Bossmann, N. Turro y D.A. Tomalia, J. *Am. Chem. Soc.* **116** (1994) 661
- 44. L. Balogh y D.J. Tomalia Am. Chem. Soc. 120 (1998)
- 45. M. Diallo, L. Balogh, A. Shafagati, J. Johnson, W. Goddard y D. Tomalia, Environmental Science & Technology, **33** (1999) 820
- 46. H. Abdullah y C. Sorrell, Journal of the Australian Ceramic Society 44 (2008) 12
- 47. A.Muñoz, Tesis Doctoral, *Nuevas Aportaciones al Desarrollo de Metodología en Química Verde*, Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra, (2003)
- J. Manriquez, Tesis Doctoral, Diseño y Construcción de Dispositivos Fotocapacitivos y Fotovoltaicos con Base en Materiales Dendríticos y Metalmacrocomplejos de Terpiridina Rutenio (II), CIDETEQ, Querétaro, (2007)
- 49. J. Manríquez y L.A. Godínez, Thin Solid Films 515 (2007) 3402
- 50. H. Yamada, H. Imahori, Y. Nishimura, I. Yamazaki, T. Ahn, S. Kim, D. Kim y S. Fukusumi, *J. Am. Chem. Soc.* **125** (2003) 9132
- 51. W. Siripala, L.D. Perera, K.T. De Silva, J.K. Jayanetti y I.M. Dharmadasa, *Solar Energy Materials and Solar Cells* **44** (1996) 251
- 52. J.O'M. Bockris, A.K.N Reddy, "*Electroquímica Moderna*", Vol 1, Reverte S.A, Barcelona, 1979, Cap. 3, p. 183
- 53 J.E. Huheey, "Química Inorgánica Principios de Estructura y Reactividad", 2ª ed, Harla, México D.F, 1981, Cap. 3, p. 55
- 54 A. J. Bard, "*Encyclopedia of Electrochemistry of the Elements*", Vol. II, Marcel Dekker, New York, 1974, Cap 5 y 6
- 55 E. Bustos-Bustos, M.G. García-Jiménez, B.R. Díaz-Sánchez, E. Juaristi, T.W. Chapman y L.A. Godínez, *Talanta* **72** (2007) 1586
- 56. J. Manríquez, E. Juaristi, O. Muñoz-Muñiz y L.A. Godínez, Langmuir **19** (2003) 7315.
- 57 U. López-García, C. Frontana, J. Manríquez y L. Godinez, *Electrochemical and Solid State Letters* **13** (2010) P7
- 58. R. Memming, "Semiconductor Electrochemistry", Wiley-VCH, Weinheim, 2001, Ch.2

- 59. F. Posso, Geoenseñanza 7 (2002) 54
- 60. R.M. Dell y D.A.J Rand, *Understanding Batteries*, RSC Paperbacks, Cambridge, 2001, 1
- 61 J. Morales, L. Sanchez, S. Bijani, L. Martínez, M. Gabás y J. Barrado, *Electrochemical and Solid-State Letters* **8** (2005) A159
- V. Bagotsky, *Fundamentals of Electrochemistry*, 2nd Ed, John Wiley & Sons, Moscow, 2006, 343
- 63. J. García, Acumuladores Electroquimicos, McGraw-Hill, Madrid, 1994, 3
- 64. C. Brett y M. Brett, Electrochemistry, Bookcraft, Portugal, 1994, 367
- 65 Y. Martínez y R. Hernández, *Electroquímica: Energía y Ambiente*, Smart Service C.A., Venezuela, 2004, 37
- 66. S.G.Bratsch, J.Phys.Chem.Ref.Data, 18 (1989) 1.
- 67 J. Morales, L. Sánchez, F. Martín, J.R Ramos-Barrado y M. Sánchez, *Electrochemica Acta* **49** (2004) 4589
- P. Poizot, S. Laruelle, S. Grugeon, L. Dupont, J.M Tarascon, *Nature* 407 (2000)
 496
- 69 J. Nordmann, Análisis Cualitativo y Química Inorgánica, CECSA, México D.F., 1968, A.18.
- 70. F.Fabregat-Santiago, G.García-Belmonte, J.Bisquert, P.Bogdanoff, A.Zaban, *J.Electrochem.Soc.*, **150** (2003) E293
- 71 C.-J. Zhong, N.T. Woods, G.B. Dawson, M.D. Porter, *Electrochemistry Communications*, **1** (1999) 17.
- 72 H. Park, E. Bae, J.-J. Lee, J. Park, W. Choi, J. Phys. Chem., **110** (2006) 8740.
- 73. Y. Li, B. Tan y Y. Wu, Nano Letters 8 (2008) 265
- 74 B. Lenis, J. Ramirez, E. Kaul, W. Lopera, J. Guimpel, M. Gómez, *Revista Colombiana de Física*, **40** (2008) 74
- 75. J. Hernández, Tesis doctoral, "Caracterización electroquímica de nanoparticulas de Oro. Relación entra la forma tridimensional de la partícula y su orientación superficial", Universidad de Alicante, Alicante (2008)
- 76. L. Pérez-Arrieta y C. Tabares-Muñoz, *Revista Mexicana de Física*, **50 (2)** (2004)
 96
- 77. H. Araki, The Rigaku Journal, 6 (1989) 34
- J. Ojeda, Métodos de Microscopia Electrónica de Barrido en Biología, Gráficas Calima, Santander, 1997, p. 23

J. Riviére y S. Myhra, Surface and Interface Analysis, 2nd Ed, CRC Press, Boca Raton, FL, 2009, p. 170